特2002-340374

【書類名】

特許願

【整理番号】

T02070

【提出日】

平成14年11月25日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B01D 19/00

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府大阪市西成区南津守5丁目1番60号 エム・テ

クニック株式会社内

【氏名】

榎村 眞一

【特許出願人】

【識別番号】

595111804

【住所又は居所】 大阪府大阪市西成区南津守5丁目1番60号

【氏名又は名称】 エム・テクニック株式会社

【代理人】

【識別番号】

100086346

【弁理士】

【氏名又は名称】 鮫島 武信

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

009612

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9507449

【プルーフの要否】

要

ENUMURA, Shinichi
July 16,2003
Birch, Shudand, Kulaschel Birch, Up.
許 庁(703) 205-2000

日本 国 特 許 庁(で3)かられい JAPAN PATENT OFFICE CO3 76211P 30f3

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年11月25日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-340374

[ST.10/C]:

[JP2002-340374]

出願人 Applicant(s):

エム・テクニック株式会社

2003年 6月24日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



[書類名] 明細書

【発明の名称】 微細化装置付脱気機及び微細化による脱気方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理物を微細化して、脱泡等の脱気処理を行う、微細化装置付脱気機において、

微細化装置は、互いに対向するように配設され少なくとも一方が他方に対して 回転する第1及び第2の少なくとも2つの円盤と、両円盤の間を所定間隔に保つ 間隔保持機構とを備え、両円盤の対向面の夫々は、鏡面研磨が施された処理用面 であり、

微細化装置は、当該処理用面間に被処理物を導入する流入部と、両処理用面から被処理物を排出する流出部とを備え、上記の回転により両処理用面間にて、被処理物の微細化の処理が行われるものであることを特徴とする微細化装置付脱気機。

【請求項2】被処理物を微細化して、脱泡等の脱気処理を行う、微細化装置 付脱気機において、

微細化装置は、第1及び第2の少なくとも2つの処理用部材と、フローティン グ機構と、付勢機構と、離反機構とを備え、

両処理用部材の夫々は、互いに対向するように配設された処理用面を備え、両 処理用部材の少なくとも一方が他方に対して回転することにより、両処理用面間 にて微細化の処理を行うものであり、

両処理用面の夫々は、鏡面研磨が施され、両処理用面の間に被処理物が供給されるものであり、

フローティング機構は、第1及び第2の処理用部材の少なくとも一方に設けられたものであり、両処理用部材間の近接・離反を可能とすると共に、回転により両処理用部材の少なくとも一方に生じた偏心挙動を、両処理用部材の少なくとも他方が吸収するものであり、

付勢機構は、両処理用部材を近接させる方向に作用させるものであり、

離反機構は、両処理用部材を離反させる方向に作用させるものであり、

離反機構は、処理用部材の少なくとも上記回転時、付勢機構の作用に抗して、

微小間隔を両処理部材間に確保することが可能なものであることを特徴とする微 細化装置付脱気機。

【請求項3】 第1及び第2の処理用部材間を通り抜けた処理物を抽出する 減圧ポンプを備えたことを特徴とする請求項2記載の微細化装置付脱気機。

【請求項4】 互いに対向するように配設され少なくとも一方が他方に対して回転することにより微細化処理を行う、第1及び第2の少なくとも2つの処理用部材を備え、上記回転の中心側から両処理用部材の間に流体を供給し、当該流体を上記第1及び第2の処理用部材の外側に排出するものであり、

上記の第1及び第2の両処理用部材は、少なくともその一方が他方に対して、 近接・離反可能に配設され、

両処理用部材を少なくとも近接させる方向に作用する付勢機構を備え、

上記の第1及び第2の処理用部材は、流体が両処理用部材間を通過しようとする力を両処理用部材の離反する方向に作用させる、動圧発生機構を備えたことを 特徴とする微細化装置付脱気機。

【請求項5】 互いに対向するように配設され少なくとも一方が他方に対して回転することにより微細化処理を行う、第1及び第2の少なくとも2つの処理用部材を備え、上記回転の中心側から両処理用部材の間に流体を供給し、当該流体を上記第1及び第2の処理用部材の外側に排出するものであり、

上記の第1及び第2の両処理用部材は、少なくともその一方が他方に対して、 近接・離反可能に配設され、

両処理用部材を少なくとも近接させる方向に作用する付勢機構を備え、

上記両処理用部材は、鏡面研磨が施された平坦部を備え、処理用部材の一方は 、平坦部に溝を備え、

上記の溝は、処理用部材の中心側から処理用部材の外側に向かって伸びると共に、当該溝内を通って、処理用部材の中心から処理用部材の外側に通り抜けようとする流体の流路を制限する、流路制限部を備えたこと特徴とする微細化装置付脱気機。

【請求項6】 上記の流路制限部は、回転の中心側から処理用部材の外側に向けて漸次溝の断面積を小さくすることによって形成されたものであることを特

徴とする請求項5記載の微細化装置付脱気機。

【請求項7】 上記の第1及び第2の処理用部材の少なくとも一方が、フローティング機構を備え、このフローティング機構は、両処理用部材間の上記近接・離反を可能とすると共に、回転により両処理用部材の少なくとも一方に生じた偏心挙動を、両処理用部材の少なくとも他方が吸収するものであることを特徴とする請求項4乃至6の何れかに記載の微細化装置付脱気機。

【請求項8】 互いに対向するように配設され少なくとも一方が他方に対して回転することにより微細化処理を行う、第1及び第2の少なくとも2つの処理用部材を備え、上記回転の中心側から両処理用部材の間に、被処理物を搬送する或いは被処理物自身となる流体を供給し、当該流体を上記第1及び第2の処理用部材の外側に排出するものであり、

フローティング機構と、付勢機構と、動圧発生機構とを備え、

フローティング機構は、上記の第1及び第2の両処理用部材の、一方を他方に対して、近接・離反可能に配すると共に、両処理用部材の回転軸の向きを変える ことを可能とするものであり、

付勢機構は、上記の両処理用部材を少なくとも近接させる方向に付勢するものであり、

動圧発生機構は、流体が両処理用部材間を通過しようとする力を、両処理用部材の離反する方向に作用させることによって、両処理用部材間の間隔を0.1~10μmの微小間隔とするものであることを特徴とする微細化装置付脱気機。

【請求項9】 被処理流動体に所定の圧力を付与する流体圧付与機構と、この所定圧力の被処理流動体が流される密封された流体流路に設けられた第1処理用部と第1処理用部に対して相対的に接近離反可能な第2処理用部(20)の少なくとも2つの処理用部と、

これらの処理用部において互いに対向する位置に設けられた第1処理用面及び 第2処理用面の少なくとも2つの処理用面と、

第1処理用部と第2処理用部とを相対的に回転させる、回転駆動機構とを備え

両処理用面間にて、上記被処理流動体の微細化の処理を行うものであり、

第1処理用部と第2処理用部のうち少なくとも第2処理用部は所定のバランス 比に設定された受圧面を備えるものであり、且つ、この受圧面の少なくとも一部 が第2処理用面により構成され、

接近離反可能且つ相対的に回転する第1処理用面と第2処理用面との間に所定 圧力の被処理流動体が通されることにより、上記被処理流動体が所定膜厚の流体 膜を形成しながら両処理用面間を通過することで、当該被処理流動体について、 所望の微細化の状態を得るものであることを特徴とする微細化装置付脱気機。

【請求項10】 第1処理用面及び第2処理用面の少なくとも一方の、微振動やアライメントを調整する緩衝機構を備えたことを特徴とする請求項9記載の微細化装置付脱気機。

【請求項11】 第1処理用面及び第2処理用面の一方又は双方の、磨耗などによる軸方向の変位を調整して、両処理用面間の流体膜の膜厚を維持することを可能とする変位調整機構を備えたものであることを特徴とする請求項9又は10記載の微細化装置付脱気機。

【請求項12】 被処理流動体に加える圧力の調整機構を備えたこと特徴とする請求項9万至11の何れかに記載の微細化装置付脱気機。

【請求項13】 上記第1処理用面と第2処理用面との間の最大間隔を規定し、それ以上の両処理用面の離反を抑止する離反抑止部を備えることを特徴とする請求項9乃至12の何れかに記載の微細化装置付脱気機。

【請求項14】 上記第1処理用面と第2処理用面との間の最小間隔を規定し、それ以上の両処理用面の近接を抑止する近接抑止部を備えることを特徴とする請求項9乃至13の何れかに記載の微細化装置付脱気機。

【請求項15】 第1処理用面と第2処理用面の双方が、互いに逆の方向に回転するものであることを特徴とする請求項9乃至14の何れかに記載の微細化装置付脱気機。

【請求項16】 上記第1処理用面と第2処理用面の一方或いは双方の温度 を調整する、温度調整用のジャケットを備えることを特徴とする請求項9乃至1 5の何れかに記載の微細化装置付脱気機。

【請求項17】 上記第1処理用面及び第2処理用面の一方或いは双方の少

なくとも一部は、鏡面加工されたものであることを特徴とする請求項9乃至16の何れかに記載の微細化装置付脱気機。

【請求項18】 上記第1処理用面及び第2処理用面の一方或いは双方は、 凹部を備えたものであることを特徴とする請求項9乃至17の何れかに記載の微 細化装置付脱気機。

【請求項19】 上記の流体通路とは独立した別途の導入路を備え、上記第1処理用面と第2処理用面の少なくとも何れ一方には、上記の導入路に通じる開口部を備え、導入路から送られてきた移送物を、上記処理中の被処理流動体に導入することが可能なものであることを特徴とする請求項9乃至18の何れかに記載の微細化装置付脱気機。

【請求項20】 被処理流動体に所定の圧力を付与する流体圧付与機構と、この所定圧力の被処理流動体が流される密封された流体流路に接続された第1処理用面及び第2処理用面の少なくとも2つの相対的に接近離反可能な処理用面と、両処理用面間に接面圧力を付与する接面圧力付与機構と、第1処理用面と第2処理用面とを相対的に回転させる回転駆動機構と、を備えることにより、両処理用面間にて、被処理流動体の微細化の処理を行うものであり、

接面圧力が付与されつつ相対的に回転する第1処理用面と第2処理用面との間に所定圧力の被処理流動体が通されることにより、上記被処理流動体が所定膜厚の流体膜を形成しながら両処理用面間を通過することで、当該被処理流動体について、所望の微細化の状態を得るものであることを特徴とする微細化装置付脱気機。

【請求項21】 被処理流動体に所定の圧力を付与し、この所定の圧力を受けた被処理流動体が流される密封された流体流路に、第1処理用面及び第2処理用面の少なくとも2つの相対的に接近離反可能な処理用面を接続し、両処理用面を接近させる接面圧力を付与し、第1処理用面と第2処理用面とを相対的に回転させ且つこれらの処理用面間に被処理流動体を通過させて、当該被処理流動体の微細化の処理を行うものであり、

少なくとも被処理流動体に付与した上記の所定の圧力を両処理用面を離反させ る離反力とし、当該離反力と上記接面圧力とを、処理用面間の被処理流動体を介 して均衡させることにより、両処理用面間を所定の微小間隔に維持し、被処理流動体を所定の厚みの流体膜として両処理用面間を通過させて、所望の微細化の状態を得るものであることを特徴とする微細化による脱気方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本願発明は、微細化装置付脱気機及び微細化による脱気方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

被処理物について脱気処理を行う脱気装置として、例えば液体から当該液体中 の泡を抜く脱泡機がある。

この脱泡機は、内部が真空のタンク (ベッセル) 内に配された円筒状の外側ロータと、当該外側ロータの内側に外側ロータと同心に配された円筒状の内側ロータと、モータによって回転する中空のシャフトとを備えたものであり、内側ロータは、上記のシャフトに接続され、外側ロータに対し相対的に回転する。

上記の筒状の内側ロータの周面部は、パンチングプレートにて形成されている。また、筒状の外側ロータの周面部は、上記パンチングプレートよりもきめの細かいスクリーンにて形成されている。

[0003]

この脱泡機の動作を次に説明する。

上記シャフト内は、脱泡処理を行う液の通路となっており、シャフト内を通って、当該液は、内側ロータ内に導入される。このように、高速回転するシャフト内部を液体が通過することにより、液相はシャフト内壁面側に、気泡はシャフト中心側へ遠心分離される。このとき、気泡は、液相に先んじて、真空下のベッセル内に引かれ、膨張し脱気される。

続いて内側ロータ内に導入された上記の液相は、回転による遠心力にて、薄膜効果が発生し脱泡が進む。そして、内部側ロータのパンチングプレートを通過し、細分化される。このように細分化されることにより、脱泡が促進する。更に、パンチングプレートを通り抜けた液は、外側ロータに接し、そのスクリーンを通

過する。当該スクリーンを通り抜けた液は、真空中で霧状にされ、ベッセル内壁 に衝突してベッセル内壁を流れ落ち脱泡が完了する。

[0004]

上記の通り、この脱泡機は、処理対象を上記のパンチングプレートやスクリーンの目へ通すことにより、主として処理対象の微細化を行う。このような微細化は、対象が内包する気泡の発散を促進させるものであり、当該脱気機は、このような作用を利用して脱気処理を円滑に行おうとするものである。

上記の微細化によって脱泡できる気泡の大きさは、上記のパンチングプレート やスクリーンの目の細かさに大きく依存する。

[0005]

しかし、パンチングプレートやスクリーンの目を細かくするには、物理的な限界があり、パンチングプレートやスクリーンの目よりも遥かに細かい気泡の除去には向かないものであった。即ち、このような構造の脱泡機では、10~20μmの微細化(霧状化)が限界であり、1~2μmといった超微細化は不可能であった。

また処理対象物が、エマルションやサスペンションの場合、あらかじめ例えば高速の攪拌機や分散機でエマルションやサスペンション化されたものを当該脱気機で脱気処理する必要があった。

また、先の処理によって、パンチングプレートやスクリーンの目が汚れ、目詰まりが生じるので、次の脱泡処理に当該脱泡機を使用する前に、これらのパンチングプレートやスクリーンを十分に洗浄する必要がある。

このようなパンチングプレートやスクリーンは洗浄性が悪く、その洗浄 (汚れの除去) は、極めて面倒な作業である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

本願発明は、上記事情に基づいてなされたものであり、上記の従来の微細化の機構と全く異なる微細化の機構を備えた脱気機を提供することにより、処理対象の更なる微細化による従来不可能とされた微細な気泡の除去を可能とし、更に、面倒なパンチングプレートやスクリーンの洗浄を不要として、上記問題の解決を

図る。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本願第1の発明に係る微細化装置付脱気機は、被処理物を微細化して、脱泡等の脱気処理を行うものであり、次の構成を採る。

微細化装置は、互いに対向するように配設され少なくとも一方が他方に対して 回転する第1及び第2の少なくとも2つの円盤と、両円盤の間を所定間隔に保つ 間隔保持機構とを備える。両円盤の対向面の夫々は、鏡面研磨が施された処理用 面である。また、この微細化装置は、当該処理用面間に被処理物を導入する流入 部と、両処理用面から被処理物を排出する流出部とを備え、上記の回転により両 処理用面間にて、被処理物の微細化の処理が行われるものである。ここで微細化 の処理とは、被処理物の表面積の拡大を目的とする場合は勿論、霧状化の粒子径 、液滴径を細かくすること、例えばエマルションやサスペンション(分散物)、 リポソームの場合、その粒子径を、細かくすることを含むものである。

脱気機は、微細化により被処理物の成分の一部を気化して抽出できるものであり、脱泡機、脱ガス機、脱モノマー機、脱溶媒機などを含む。

[0008]

本願第2の発明に係る微細化装置付脱気機は、被処理物を微細化して、脱泡等 の脱気処理を行うものであり、次の構成を採る。

微細化装置は、第1及び第2の少なくとも2つの処理用部材と、フローティン が機構と、付勢機構と、離反機構とを備える。両処理用部材の夫々は、互いに対 向するように配設された処理用面を備え、両処理用部材の少なくとも一方が他方 に対して回転することにより、両処理用面間にて微細化の処理を行うものである 。両処理用面の夫々は、鏡面研磨が施され、両処理用面の間に被処理物が供給さ れるものである。フローティング機構は、第1及び第2の処理用部材の少なくと も一方に設けられたものであり、両処理用部材間の近接・離反を可能とすると共 に、回転により両処理用部材の少なくとも一方に生じた偏心挙動を、両処理用部 材の少なくとも他方が吸収するものである。付勢機構は、両処理用部材を近接さ せる方向に作用させるものであり、離反機構は、両処理用部材を離反させる方向 に作用させるものである。また、離反機構は、処理用部材の少なくとも上記回転 時、付勢機構の作用に抗して、微小間隔を両処理部材間に確保することが可能な ものである。

[0009]

本願第3の発明に係る微細化装置付脱気機は、上記本願第2の発明に係る微細化装置付脱気機にあって、第1及び第2の処理用部材間を通り抜けた処理物を抽出する減圧ポンプを備えたことを特徴とする。

[0010]

本願第4の発明に係る微細化装置付脱気機は、互いに対向するように配設され少なくとも一方が他方に対して回転することにより微細化処理を行う、第1及び第2の少なくとも2つの処理用部材101,102を備え、上記回転の中心側から両処理用部材101,102の外側に排出するものである。上記の第1及び第2の処理用部材101,102は、少なくともその一方が他方に対して、近接・離反可能に配設されている。両処理用部材101,102を少なくとも近接させる方向に作用する付勢機構103を備える。上記の第1及び第2の処理用部材101,102は、流体が両処理用部材101,102間を通過しようとする力を両処理用部材101,102の離反する方向に作用させる、動圧発生機構104を備える。

[0011]

本願第5の発明に係る微細化装置付脱気機は、互いに対向するように配設され少なくとも一方が他方に対して回転することにより微細化処理を行う、第1及び第2の少なくとも2つの処理用部材101,102を備え、上記回転の中心側から両処理用部材101,102の間に流体を供給し、当該流体を上記第1及び第2の処理用部材101,102の外側に排出するものである。上記の第1及び第2の両処理用部材101,102は、少なくともその一方が他方に対して、近接・離反可能に配設されている。両処理用部材101,102を少なくとも近接させる方向に作用する付勢機構103を備える。上記両処理用部材101,102は、鏡面研磨が施された平坦部を備え、処理用部材の一方は、平坦部に溝を備え

る。上記の溝は、処理用部材の中心側から処理用部材の外側に向かって伸びると 共に、当該溝内を通って、処理用部材の中心から処理用部材の外側に通り抜けよ うとする流体の流路を制限する、流路制限部を備える。

[0012]

本願第6の発明に係る微細化装置付脱気機では、上記本願第5の発明に係る微細化装置付脱気機にあって、上記の流路制限部は、回転の中心側から処理用部材の外側に向けて漸次溝の断面積を小さくすることによって形成されたものである

[0013]

本願第7の発明に係る微細化装置付脱気機では、上記本願第4万至6の何れかの発明に係る微細化装置付脱気機にあって、上記の第1及び第2の処理用部材101,102の少なくとも一方が、フローティング機構を備え、このフローティング機構は、両処理用部材101,102間の上記近接・離反を可能とすると共に、回転により両処理用部材101,102の少なくとも一方に生じた偏心挙動を、両処理用部材101,102の少なくとも他方が吸収するものであることを特徴とする。

[0014]

本願第8の発明に係る微細化装置付脱気機は、互いに対向するように配設され少なくとも一方が他方に対して回転することにより微細化処理を行う、第1及び第2の少なくとも2つの処理用部材101,102を備え、上記回転の中心側から両処理用部材101,102の間に、被処理物を搬送する或いは被処理物自身となる流体を供給し、当該流体を上記第1及び第2の処理用部材101,102の外側に排出するものである。フローティング機構と、付勢機構と、動圧発生機構とを備える。フローティング機構は、上記の第1及び第2の両処理用部材101,102の、一方を他方に対して、近接・離反可能に配すると共に、両処理用部材101,102の回転軸の向きを変えることを可能とするものである。付勢機構は、上記の両処理用部材101,102を少なくとも近接させる方向に付勢するものである。動圧発生機構は、流体が両処理用部材101,102間を通過しようとする力を、両処理用部材101,102の離反する方向に作用させるこ

とによって、両処理用部材 $1 \ 0 \ 1$, $1 \ 0 \ 2$ 間の間隔を $0 \ .$ $1 \ \sim 1 \ 0$ μ mの微小間隔とするものである。

[0015]

本願第9の発明に係る微細化装置付脱気機は、被処理流動体に所定の圧力を付与する流体圧付与機構と、この所定圧力の被処理流動体が流される密封された流体流路に設けられた第1処理用部10と第1処理用部10に対して相対的に接近離反可能な第2処理用部20の少なくとも2つの処理用部と、これらの処理用部10,20において互いに対向する位置に設けられた第1処理用面1及び第2処理用面2の少なくとも2つの処理用面と、第1処理用部10と第2処理用部20とを相対的に回転させる回転駆動機構とを備え、両処理用面1,2間にて、上記被処理流動体の微細化の処理を行うものである。第1処理用部10と第2処理用部20のうち少なくとも第2処理用部20は所定のバランス比に設定された受圧面を備えるものであり、且つ、この受圧面の少なくとも一部が第2処理用面2により構成されている。接近離反可能且つ相対的に回転する第1処理用面1と第2処理用面2との間に所定圧力の被処理流動体が通されることにより、上記被処理流動体が所定膜厚の流体膜を形成しながら両処理用面1,2間を通過することで、当該被処理流動体について、所望の微細化の状態を得るものである。

[0016]

本願第10の発明に係る微細化装置付脱気機は、上記本願第9の発明に係る微細化装置付脱気機にあって、第1処理用面1及び第2処理用面2の少なくとも一方の、微振動やアライメントを調整する緩衝機構を備えたことを特徴とする。

[0017]

本願第11の発明に係る微細化装置付脱気機は、上記本願第9又は10の発明に係る微細化装置付脱気機にあって、第1処理用面1及び第2処理用面2の一方又は双方の、磨耗などによる軸方向の変位を調整して、両処理用面1,2間の流体膜の膜厚を維持することを可能とする変位調整機構を備えたものであることを特徴とする。

[0018]

本願第12の発明に係る微細化装置付脱気機は、上記本願第9乃至11の何れ

かの発明に係る微細化装置付脱気機にあって、被処理流動体に加える圧力の調整 機構を備えたこと特徴とする。

[0019]

本願第13の発明に係る微細化装置付脱気機は、上記本願第9乃至12の何れかの発明に係る微細化装置付脱気機にあって、上記第1処理用面1と第2処理用面2との間の最大間隔を規定し、それ以上の両処理用面1,2の離反を抑止する離反抑止部を備えることを特徴とする。

[0020]

本願第14の発明に係る微細化装置付脱気機は、上記本願第9乃至13の何れかの発明に係る微細化装置付脱気機にあって、上記第1処理用面1と第2処理用面2との間の最小間隔を規定し、それ以上の両処理用面1,2の近接を抑止する近接抑止部を備えることを特徴とする。

[0021]

本願第15の発明に係る微細化装置付脱気機では、上記本願第9乃至14の何れかの発明に係る微細化装置付脱気機にあって、第1処理用面1と第2処理用面2の双方が、互いに逆の方向に回転するものである。

[0022]

本願第16の発明に係る微細化装置付脱気機では、上記の本願第9乃至15の何れかの発明に係る微細化装置付脱気機にあって、上記第1処理用面1と第2処理用面2の一方或いは双方の温度を調整する、温度調整用のジャケットを備える

[0023]

本願第17の発明に係る微細化装置付脱気機では、上記本願第9乃至16の何れかの発明に係る微細化装置付脱気機にあって、上記第1処理用面1及び第2処理用面2の一方或いは双方の少なくとも一部が、鏡面加工されたものであることを特徴とする。

[0024]

本願第18の発明に係る微細化装置付脱気機では、上記本願第9乃至17の何 れかの発明に係る微細化装置付脱気機にあって、上記第1処理用面1及び第2処 理用面2の一方或いは双方は、凹部を備えたものである。

[0025]

本願第19の発明に係る微細化装置付脱気機は、上記本願第9乃至18の何れかの発明に係る微細化装置付脱気機にあって、上記の流体通路とは独立した別途の導入路を備え、上記第1処理用面1と第2処理用面2の少なくとも何れ一方には、上記の導入路に通じる開口部を備え、導入路から送られてきた移送物を、上記処理中の被処理流動体に導入することが可能なものである。

[0026]

本願第20の発明に係る微細化装置付脱気機は、被処理流動体に所定の圧力を付与する流体圧付与機構と、この所定圧力の被処理流動体が流される密封された流体流路に接続された第1処理用面1及び第2処理用面2の少なくとも2つの相対的に接近離反可能な処理用面と、両処理用面1,2間に接面圧力を付与する接面圧力付与機構と、第1処理用面1と第2処理用面2とを相対的に回転させる回転駆動機構と、を備えることにより、両処理用面1,2間にて、被処理流動体の微細化の処理を行うものである。この微細化装置付脱気機では、接面圧力が付与されつつ相対的に回転する第1処理用面1と第2処理用面2との間に所定圧力の被処理流動体が通されることにより、上記被処理流動体が所定膜厚の流体膜を形成しながら両処理用面1,2間を通過することで、当該被処理流動体について、所望の微細化の状態を得るものである。

[0027]

本願第21の発明に係る微細化による脱気方法では、被処理流動体に所定の圧力を付与し、この所定の圧力を受けた被処理流動体が流される密封された流体流路に、第1処理用面1及び第2処理用面2の少なくとも2つの相対的に接近離反可能な処理用面を接続し、両処理用面1,2を接近させる接面圧力を付与し、第1処理用面1と第2処理用面2とを相対的に回転させ且つこれらの処理用面1,2間に被処理流動体を通過させて、当該被処理流動体の微細化の処理を行う。この脱気方法は、少なくとも被処理流動体に付与した上記の所定の圧力を両処理用面1,2を離反させる離反力とし、当該離反力と上記接面圧力とを、処理用面1,2間の被処理流動体を介して均衡させることにより、両処理用面1,2間を所

定の微小間隔に維持し、被処理流動体を所定の厚みの流体膜として両処理用面 1 , 2 間を通過させて、所望の微細化の状態を得るものである。

[0028]

上記の構成を採る本願第1乃至21の発明は、被処理物を微細化して脱泡等の脱気処理を行う、微細化装置付脱気機において、2つの処理用面の少なくとも一方を回転して、もう一方の処理用面との間にて、処理対象の微細化を行うという新規な微細化の手段を提供したものであり、このように、微細化のために、従来のパンチングプレートやメッシュという構成を排除して、これら部材の面倒な洗浄という作業を不要とした。

そして、パンチングプレートやメッシュでは、不可能であった微細な気泡の抽出(排除)を可能とした。また、この脱気機は、2つの利点がある。その1点は、霧状に噴出する時の液滴径についてであり、これは、真空雰囲気に曝される表面積即ち界面の面積を多くし(大きくし)脱気能力を増大することができという点である。もう1点は、通常乳化機などで処理されたものは脱気機に導入される場合が多く、この点、この発明に係る脱気機は、その乳化機と脱気機とを1台で済ませることができるということである。

上記の通り、この脱気機は、微細化装置によって、被処理物を気泡を含んだ液体とする場合、上記にて、液体を微細化することにより、液体が内包する気体を発散しやすいものとしたものである。被処理対象については、上記ように気泡を内包する液体に限られず、二種以上の液状成分を有する液体から、一部の液状成分を微細化して気化させ、他の液状成分と分離するのにも用いることができる。また、被処理対象が、固体の混合物や化合物であり、その固形分について微細化による気化の促進により除去できるものであれば、これを含むものである。例えば、被処理物をポリマーとした場合、当該ポリマー中の不要なモノマー(揮発性物質)を微細化して気化させて除去することができる。被処理物が、固体と液体とが混合したものである場合も、気体部と液体部の何れか一方について、微細化により除去するのに、この脱気機を用いることができる。

また、脱気機には、被処理物中の水分も(微細化により)水蒸気として抜くことができるものも含む。

[0029]

特に、本願第2の発明にあっては、上記の微細化装置付脱気機にあって、フローティング機構を備えることにて、微細化のために、必要とされる両処理用面間の微小間隔を、回転や各部の膨張係数の差にて回転で生じた熱による歪みで阻害されることなく、確実に維持できるものとし、精度の高い処理を可能とした。

また、本願第3の発明にあっては、微細化した被処理物を減圧ポンプにより減圧することにより、その移動を確実に行えるものとした。また、このような減圧ポンプによる減圧を利用して、微細化後の被処理物の、除去しようとする気体の気化を促進し、液状部との分離をより、確実なものとした。

具体的には、脱泡の場合を例に採ると、減圧ポンプにより、真空或いは真空に近い状態に減圧することにより、微細化された被処理物は、界面積が増大し、且つ微小な気泡が膨張し、被処理物に内包されているガス、溶剤、モノマー(揮発性物質)を蒸気等に気化して抜くことができる(これらのガス等を抽出の目的物とする場合も同様の作用にて当該抽出を行うことができる)。

上記の真空度(減圧の程度)は、気化させるものと残るものとの分離に適する ように設定すればよい。

[0030]

とりわけ、本願の上記第4乃至第8の発明に係る脱気機は、メカニカルシールにおける軸封の機構を、微細化のための手段として利用するという独創的な発想により、高精度の微細化の処理が出来しかも生産性の高い、シンプルな構造の脱気機を提供することを可能とし、上記問題の解決を図ったものであり、相対的に回転する少なくもと2つの処理用面間の間隔を所定の微小間隔に設定することができ、大きなせん断力を被処理流動体に与えることができる微細化装置を備えた脱気機を提供し、更に、被処理流動体の適応粘度領域が広い脱気装置を提供する

即ち、本願の上記第4乃至第8の発明に係る脱気機は、上記の構成を採ることにより、付勢機構103の付勢に対し、動圧発生機構104が流体の両処理用部材101,102間を通過しようとする力を利用して両処理用部材101,102間の離反力を発生させ、少なくとも、付勢機構103の付勢と当該離反力との

均衡により、両処理用部材101, 102間について、機械的な方法では不可能 であった、処理に必要な微小な間隔を確保することを可能とした。

[0031]

特に、本願第5の発明に係る脱気機は、上記の動圧発生機構104について、より好ましい手段を提供し得たものである。即ち、上記本願第5の発明に係る脱気機は、双方の処理用部材101,102に鏡面研磨による平坦部を具備せしめると共に、当該平坦部の一方に、処理用部材の中心側から処理用部材の外側に流体が移動する経路を提供する溝を設けて、当該溝を鏡面研磨された両平坦部及び流路制限部にて、囲まれた空間とする。このため、溝を通り抜けようとする流体が流路制限部によって行き場を失い、少なくとも付勢機構103にて押し合わされた両平坦部の間に入り込み、両平坦部間(両処理用部材101,102間)に、機械的な方法では不可能であった、微細化の処理に適した微小間隔を確保する

また、本願第6の発明に係る脱気機では、流路制限部が、回転の中心側から処理用部材の外側に向けて漸次溝の断面積を小さくすることによって、流体の通り抜けようとする力を徐々に受けるものであり、より円滑な上記の微小間隔の確保を可能とした。

更に、本願第7の発明に係る脱気機では、処理用部材101,102が、フローティング機構によって、両処理用部材間の上記近接・離反のみならず、回転により両処理用部材101,102の少なくとも一方に生じた偏心挙動を、両処理用部材101,102の少なくとも他方が吸収する。このため、回転や発生した熱による処理用部材の変形によって、両平坦部間(両処理用部材101,102間)の各位置における間隔の不均衡を是正し、両平坦部間(両処理用部材101,102間)の各位置における隙間を一定のものとして、より確実で均一な処理を可能とした。

即ち、フローティング機構によって、上記回転における、回転軸の芯振れ、軸 膨張、第1処理用部材101の面振れ、振動を吸収することができ、上記の作用 を奏することができる。

本願第8の発明に係る脱気機は、フローティング機構の下、付勢機構と動圧発

生機構とにおいて生じた力の均衡により、両処理用部材間の間隔を0.1~10 μmの微小間隔とし、従来不可能であった微細化処理を実現した。

[0032]

本願第9の発明にあっては、第1処理用面1と第2処理用面2の間隔を、従来他の分野で行われているような機械的に一定に保つという方式とは全く異なる発想により、所定の微小間隔に設定するようにした微細化装置を備えた脱気機を提供する。即ち、上記の通り、メカニカルシールに用いられ原理を利用して、受圧面を所定のバランス比に設定しておくことにより、被処理用流動体に掛けた所定の圧力を、第1処理用部10及び第2処理用部20の接近又は離反に作用させる。受圧面として、第2処理用面2は、両処理用部を離反させる方向に、上記の所定の圧力を作用させる。受圧面として、第2処理用面2は、両処理用部を離反させる方向に、上記の所定の圧力を作用させる。

第2処理用部20には、必要に応じて、第2処理用面2の他、第2処理用面2 と反対側を臨む受圧面(近接用調整面)と、第2処理用面2と同じ側に形成され た受圧面(離反用調整面)とを設定することができる。

この場合第2処理用面2と離反用調整面とは、被処理用流動体に掛けた所定の 圧力を受けて、第1処理用部10に対して第2処理用部20を離反させる方向に 移動させる力を発生する。但し不要であれば、上記の離反用調整面は、設けなく てもよい(ここで、離反用調整面を設ける場合は、第2処理用面2と離反用調整 面の双方を纏めて離反用面と称する。離反用調整面を設けない場合、離反用面は 、第2処理用面2そのものである)。

そして、近接用調整面は、被処理用流動体に掛けた所定の圧力を受けて、第1 処理用部10に対して第2処理用部20を接近させる方向に移動する力を発生する(近接用調整面が複数ある場合、全近接用調整面を纏めて近接用面と呼ぶ。近接用調整面が1つの場合は、当該近接用調整面のみが近接用面である)。

この場合、このような両処理用部を接近させる方向に上記所定の圧力を働かせる近接用面の面積と、離反用面の面積との比(面積比)をバランス比と呼び、近接用面の面積を離反用面の面積よりも大きくすることによって、上記所定の圧力のうち両処理用部を接近する方に働く力を離反させる方に働く力よりも大きいも

のとすることができる。

逆に、離反用面の面積を近接用面の面積よりも大きくすることによって、上記 所定の圧力のうち両処理用部を離反する方に働く力を接近させる方に働く力より も大きいものとすることができる。

また、上記の近接用面を設けないことにより、上記所定の圧力を全て離反用面で受け、当該所定の圧力の全てを上記の離反に働く力とすることができる。

これにて、他の要因によって生じた、両処理用部を接近させる力或いは離反させる力に対して、被処理用流動体に掛けた所定の圧力による両処理用部の接近又は離反の作用とを均衡させ、上記第1処理用面1と第2処理用面2との間に所望の微小な膜厚の流体膜を形成することができるのである。

即ち、このように、両処理用面1、2間を微小間隔に調整することにより、必要な大きさの剪断力を被処理流動体に付与することができる。その結果、従来得ることがでなかった超微細化を、実現した。即ち、被処理流動体に対して、両処理用面1,2間を通過する際、一定の微小隙間で大きなせん断力が与えられるものであり、かつ一定の微小な隙間より霧状に噴出することにより、10ミクロン以下のオーダーの微細化を可能として、そのようなレベルの微細な気泡の抽出(除去)を可能とした。即ち、両処理用部10,20間の間隔を、従来の(パンチングプレートやメッシュを用いる)方法では、物理的に不可能であった微小なものとすることを可能として、より微小な微細化を実現して、より細かい気泡の脱気を可能とした。

[0033]

本願第10の発明にあっては、緩衝機構を備えることにより、芯振れなどのアライメントを吸収し、接触による磨耗などを原因とする事故の危険性を排除することができる。

本願第11の発明にあっては、上記の変位調整機構にて、第1処理用面1及び第2処理用面2の間隔を保ち、流体膜の膜厚を所定の厚みに維持することにより、長期に渡って、確実な微細化処理を行うことが可能となり、脱気処理をより精度良く行えるものとした。

本願第12の発明にあっては、被処理流動体に加える圧力の調整機構にて、第

1 処理用面 1 と第 2 処理用面 2 との間の隙間を調整できるので、これにて上記の流体膜の厚みの調整が可能である。従って、当該調整にて所望の微細化処理を選択し得、被処理流動体の粘度などの特性に合わせ脱気性能の向上が可能となり、また除去しようする気泡の大きさ(細かさ)にきめ細やかに対応することができる。

[0034]

本願第13の発明にあっては、上記の第1処理用面1と第2処理用面2との間の最大間隔を規定し、それ以上の両処理用面1,2の離反を抑止する離反抑止部を備えるため、第1処理用面1と第2処理用面2との間の隙間が必要以上に広がることを防止し、均一な微細化の処理を確実且つ円滑に行うことを可能とした。

本願第14の発明にあっては、上記の第1処理用面1と第2処理用面2との間の最小間隔を規定し、それ以上の両処理用面1,2の近接を抑止する近接抑止部を備えることによって、第1処理用面1と第2処理用面2との間の隙間が必要以上に狭まることを防止し、微細化の処理を確実且つ円滑に行うことを可能とした

[0035]

本願第15の発明にあっては、第1処理用面1と第2処理用面2の双方が、互いに逆の方向に回転するものであり、このように、第1処理用面1と第2処理用面2の双方を互いに逆の方向に回転させるとによって、より大きな剪断力を発生させることが可能となり、より微小なオーダーの処理を可能とし、効率良く脱気を行うことを可能とした。

本願第16の発明にあっては、温度調整用のジャケットにて、第1処理用面1 及び第2処理用面2の一方或いは双方を、微細化の処理を行うのに適した温度に 加熱或いは冷却することを可能として、より能率良くまた、確実な微細化の処理 を可能とした。

[0036]

本願第17の発明にあっては、鏡面加工にて、第1処理用面1及び第2処理用面2間における上記微細化の処理をより高精度に行うことを可能とし、またより 微細な処理を実現し得た。 本願第18の発明にあっては、第1処理用面1又は第2処理用面2或いはその 双方に凹部を形成することにより、攪拌能力を高めて、より効率的な微細化の処理を可能とし、また回転時凹部に動圧が発生することにより非接触で回転し確実 に流体膜を形成する。

本願第19の発明にあっては、処理を施す被処理流動体に対して、所望とする 別途の物質や被処理流動体を、適宜混入することを可能として、装置の利用の範 囲を広範なものとした。

[0037]

本願第20の発明にあっては、密封された流体流路に接続された第1処理用面11と第2処理用面12の間に、所定の圧力が付与された被処理流動体が通され、これにより、第1処理用面11と第2処理用面12とを離反させる力が作用する。他方、両処理用面1、2間には、接面圧力付与機構により接面圧力が付与され、且つ、相対的に接近離反可能であると同時に回転する第1処理用面1と第2処理用面2との間に被処理流動体を通過させる。その結果、処理流動体により両処理用面1、2間を離反させる方向に加えられる力と、接面圧力付与機構によって両処理用面1、2間に付与される接面圧力とが均衡し、両処理用面1、2間の間隔が所定の微小間隔に保たれるものであり、被処理流動体は流体膜を形成しながら両処理用面1、2間を通過する。

上記の接面圧力付与機構については、第1処理用面1と第2処理用面2とを近接させる方向に力を加えるものであり、スプリング、空気圧又は油圧等の流体圧 (正圧)の加圧装置、被処理流動体に掛けた所定の圧力受けて両処理用面1,2 を接近させる方向に働く接近用の受圧面の、少なくとも何れか一つにより構成することができる。

一方、このような接面圧力付与機構の押圧力(接面圧力)に抗する両処理用面 1,2を離反させる離反力としては、第1或いは第2処理用面1,2などの被処 理流動体に掛けた所定の圧力を離反方向に働かせる受圧面において受けた当該圧 力、第1処理用面1と第2処理用面2とを相対的に回転させることによって生じ た遠心力、空気圧又は油圧等の流体圧(負圧)を利用した吸引装置による吸引力 、比処理流動体の粘性などを掲げることができる。 上記のバランス比の設定により、被処理流動体に掛けた所定の圧力のうち、接面圧力付与機構による押圧力として作用するものと、離反力として作用するものとの、大小を決定することができる。

被処理流動体は、上記の接面圧力と離反力の均衡の上で、被処理流動体は所定の微小厚さを有する流動体(即ち、流体膜)を形成して、両処理用面1、2間を通過するものであり、所定膜厚を示すように上記諸条件を調整することにより、両処理用面1、2間の間隔が所定の微小間隔に保たれた状態となる。

[0038]

本願第21の発明にあっては、従来不可能であった脱気における被処理物の超 微細化を可能とし、また、従来の脱気処理中の微細化に必要であったパンチング プレートやメッシュを不要として、その洗浄という手間を排除した。

[0039]

【発明の実施の形態】

以下、図面に基づき本願発明の実施の形態について説明する。

図1及び図2(A)へ本願発明の一実施の形態を示す。この図1は、本願発明に係る脱気機の微細化装置Gの一部切欠縦断面図である。図2(A)は、図1に示す脱気機の要部略縦断面図である。

説明の便宜上、各図中、Uは上方を、Sは下方を示している。

[0040]

先ず、脱気機の構成について説明する。

この脱気機は、微細化装置Gと、減圧ポンプなどの周知の減圧装置(この実施の形態において図示せず。)とを備える。

上記の微細化装置Gは、被処理流動体に対する、ミクロン単位からナノメータ 単位の微小なオーダーの微細化の処理に適したものであり、単一液体及び液体同 士、液体と固体(粉体)、固体(粉体)同士、気体と液体、或いは、気体と固体 (粉体)について、除去(抽出)成分の脱気による処理を施すのに適したもので ある。

図1に示す通り、この微細化装置は、第1ホルダ11 (メイティングリングホルダ)と、第1ホルダ11の前方(上方)に配置された第2ホルダ21 (コンプ

レッションリングホルダ)と、第2ホルダ21と共に第1ホルダ11を覆うケース3と、流体圧付与機構pと、接面圧付与機構4とを備える。

以下微細化装置の構成について、順に説明する。

[0041]

第1ホルダ11には、第1処理用部10と、回転軸50と、攪拌羽根6とが設けられている。

第1処理用部10は、メイティングリングと呼ばれる金属製の環状体であり、 鏡面加工された第1処理用面1を備える。

回転軸50は、第1ホルダ11の中心にボルトなどの固定具51にて固定されたものであり、その後端が電動機などの回転駆動装置5(回転駆動機構)と接続され、回転駆動装置5の駆動力を第1ホルダ11に伝えて、当該第1ホルダ11を回転させる。第1処理用部10は、回転軸50と同心に第1ホルダ11前部(上端)へ取り付けられ、回転軸50の回転にて、上記第1ホルダ11と一体となって回転する。また、攪拌羽根6は、プレ攪拌(微細化の前処理)を行うために設けられたものであり、第1ホルダ11前部(上面)において、環状の第1処理用部10の内側に、回転軸50と同心となるように第1ホルダ11に軸止されている。

[0042]

第1ホルダ11の前部(上面)には、第1処理用部10を受容することが可能な受容部が設けられており、当該受容部内にOリングと共に第1処理用部10をはめ込むことにて、第1ホルダ11への第1処理用部10の上記取付けが行われている。更に、第1処理用部10は、回り止めピン12にて、第1ホルダ11に対して回転しないように固定されている。但し回り止めピン12に代え、焼き嵌めなどの方法にて、回転しないように固定するものとしても良い。

上記の第1処理用面1は、第1ホルダ11から露出して、第2ホルダ21側を 臨む。この第1処理用面1は、第1ホルダ11にはめ込まれてから、研磨やラッ ピング、ポリッシングなどの鏡面加工を施すのが好ましい。

第1処理用部10の材質は、セラミックや焼結金属、耐磨耗鋼、その他金属に 硬化処理を施したものや、硬質材をライニングやコーティング、メッキなどを施 工したものを採用する。特に、回転するため、軽量な素材にて第1処理用部10 を形成するのが望ましい。

[0043]

上記のケース3は、軸挿通口31と、排出部32とを備えた有底の容器であり、その内部空間30に、上記の第1ホルダ11を収容する。軸挿通口31は、ケース3の底部中央に設けられ、ケース3の内外を連絡する貫通口であり、上記の回転軸50を挿通するものである。ケース3外部(下方)に配置された回転駆動装置5から上記の軸挿通口31を通じて回転軸50先端をケース3内部に挿通せしめ、上記の通りケース3内の第1ホルダ11と回転軸50とを接続する。

[0044]

第2ホルダ21には、第2処理用部20と、被処理流動体の導入部22と、接面圧力付与機構4とが設けられている。

第2処理用部20は、コンプレッションリングと呼ばれる金属製の環状体であり、鏡面加工された第2処理用面2と、第2処理用面2の内側に位置して当該第・2処理用面2に隣接する受圧面23(以下離反用調整面23と呼ぶ。)とを備える。図示の通り、この離反用調整面23は、傾斜面である。第2処理用面2に施す鏡面加工は、第1処理用面1と同様の方法を採用する。また、第2処理用部20の素材についても、第1処理用部10と同様のものを採用する。離反用調整面23は、環状の第2処理用部20の内周面25と隣接する。

[0045]

第2ホルダ21の底部(下部)には、収容部40が形成され、その収容部40 内に、上記のOリングと共に第2処理用部20が受容されている。また、回り止め45にて、第2処理用部20は、第2ホルダ21に対して回転しないよう、受容されている。上記の第2処理用面2は、第2ホルダ21から露出する。

第2ホルダ21は、図1に示すように、ケース3の開口部(上部)に配置されて当該開口部を覆い、周知の密閉手段33にて、ケース3の内部空間30を密閉する。この状態において、第2処理用面2は、ケース3内にて、第1処理用部10の第1処理用面1と対面する。この処理用面1,2間において、第1処理用部10及び第2処理用部20の内側(中心側)が、(請求項1の)被処理物の流入

部であり、第1処理用部10及び第2処理用部20の外側が、(請求項1の)被 処理物の流出部である。

[0046]

流体圧付与機構 p は、第 2 ホルダ 2 1 の外部(上部)において、上記の導入部 2 2 と接続されている。この流体圧付与機構 p は、微細化の処理を施す被処理流動体に、一定の送り込み圧を掛けるコンプレッサなどの加圧装置である。

[0047]

接面圧力付与機構4は、第1処理用面1に対して第2処理用面2を、圧接又は 近接した状態に押圧するものであり、この接面圧力と流体圧力(被処理流動体の 流体圧)等の両処理用面1、2間を離反させる力との均衡によって、上記の所定 膜厚の流体膜を発生させる(言い換えれば、両処理用面1、2間の間隔を所定の 微小間隔に保つ)。

具体的には、この実施の形態において、接面圧力付与機構4は、上記の収容部41と、収容部41の奥に(最深部)に設けられた発条受容部42と、スプリング43と、エア導入部44とにて構成されている。

但し、接面圧力付与機構4は、上記収容部41と、上記発条受容部42と、スプリング43と、エア導入部44の少なくとも、何れか1つを備えるものであればよい。

[0048]

収容部41は、収容部41内の第2処理用部20の位置を深く或いは浅く(上下に)変位することが可能なように、第2処理用部20を遊嵌している。

上記のスプリング43の一端は、発条受容部42の奥に当接し、スプリング43の他端は、収容部41内の第2処理用部20の前部(上部)と当接する。図1において、スプリング43は、1つしか現れていないが、複数のスプリング44にて、第2処理用部20の各部を押圧するものとするのが好ましい。即ち、スプリング43の数を増やすことによって、より均等な押圧力を第2処理用部20に与えることができるからである。従って、第2ホルダ21については、スプリング43が数本から数十本取付けられたマルチ型とするのが好ましい。

[0049]

この実施の形態において、上記の通りエア導入部44にて他から、空気を収容部41内に導入することを可能としている。このような空気の導入により、収容部41と第2処理用部20との間を加圧室として、スプリング43と共に、空気圧を押圧力として第2処理用部20に与えることができる。従って、エア導入部44から導入する空気圧を調整することにて、運転中に(第1処理用面1に対する第2処理用面2の)接面圧力を調整することが可能である。尚空気圧を利用するエア導入部44の代わりに、油圧などの他の流体圧にて押圧力を発生させる機構を利用しても実施可能である。

接面圧力付与機構4は、上記の押圧力(接面圧力)の一部を供給し調節する他、変位調整機構と、緩衝機構とを兼ねる。

詳しくは、接面圧力付与機構4は、変位調整機構として、始動時や運転中の軸方向への伸びや磨耗による軸方向変位にも、空気圧の調整によって追従し、当初の押圧力を維持できる。また、接面圧力付与機構4は、上記の通り、第2処理用部20を変位可能に保持するフローティング機構を採用することによって、微振動や回転アライメントの緩衝機構としても機能するのである。

[0050]

以上の構成を備えた第1の実施の形態に係る脱気機にあっては、次の作用により、脱気の処理がなされる。

まず、処理を施す被処理流動体が、流体圧付与機構 p から一定の送圧を受けて、密閉されたケース3の内部空間へ、導入部22より導入される。他方、回転駆動装置5(回転駆動機構)によって、第1処理用部10が回転する。これにより、第1処理用面1と第2処理用面2とは微小間隔を保った状態で相対的に回転する。

ケース3の内部空間に導入された被処理流動体は、(流入部から入り)微小間隔を保った両処理用面1,2間で、流体膜となり、第1処理用面1の回転により第2処理用面2との間で剪断を受けることにて微細化される。ここで、第1処理用面1と第2処理用面2とは、1μmから1mm(特に、1μmから10μm)の微小間隔に調整されることにより、数nm単位の超微粒化をも可能とする。

処理された被処理流動体は、両処理用面1,2間を経て(流出部から出て)、

排出部32から排出される。排出部32から、排出された被処理物は、既述の減 圧装置にて、真空或いは減圧された雰囲気内にて霧状にされ、雰囲気内の他に当 たることによって流動体として流れ落ちたものが脱気後の液状物として回収され る。

この実施の形態において、図1に示すように、ケース3が設けられているが、このようなケース3を微細化装置Gに設けずに実施することが可能である(図示しない)。例えば、脱気機を減圧タンク(真空タンク)として、そのタンク内部に、微細化装置Gを配置して、実施することが可能である。その場合、当然上記の排出部32は、微細化装置Gには備えられない。

尚、攪拌羽根6は、上記被処理流動体の送圧を受けて第1ホルダ11に対して回転し、上記の両処理用面1,2間における処理に先立ち、被処理流動体を攪拌する。

[0051]

上記のように、第1処理用面1と第2処理用面2とは、機械的なクリアランスの設定では不可能とされた μ m単位の微小間隔に調整され得るものであるが、そのメカニズムを次に説明する。

第1処理用面1と第2処理用面2とは、相対的に接近離反可能であり、且つ相対的に回転する。この例では、第1処理用面1が回転し、第2処理用面2が軸方向に摺動して第1処理用面に対して接近離反する。

よって、この例では、第2処理用面2の軸方向位置が、力(前述の接面圧力と離反力)のバランスによって、μm単位の精度で設定されることにより、両処理用面1,2間の微小間隔の設定がなされる。

[0052]

接面圧力としては、接面圧力付与機構4において、エア導入部44から正圧(空気圧)を付与した場合の当該圧力、スプリング43の押圧力を挙げることができる。

他方、離反力としては、離反側の受圧面(即ち、第2処理用面2及び離反用調整面23)に作用する流体圧と、第1処理用部1の回転による遠心力と、エア導入部44に負圧を掛けた場合の当該負圧とを挙げることができる。

そして、これらの力の均衡によって、第2処理用面2が第1処理用面1に対して所定の微小間隔を隔てた位置にて安定することにより、μm単位の精度での設定が実現する。

[0053]

離反力をさらに詳しく説明する。

まず、流体圧に関しては、密閉された流路中にある第2処理用部20は、流体 圧付与機構pから被処理流動体の送り込み圧力(流体圧)を受ける。その際、流 路中の第1処理用面に対向する面(第2処理用面2と離反用調整面23)が離反 側の受圧面となり、この受圧面に流体圧が作用して、流体圧による離反力が発生 する。

次に、遠心力に関しては、第1処理用部10が高速にすると、流体に遠心力が 作用し、この遠心力の一部は両処理用面1,2を互いに遠ざける方向に作用する 離反力となる。

更に、上記のエア導入部44から負圧を(第2処理用部20へ)与えた場合には、当該負圧が離反力として作用する。

以上、本願の説明においては、第1第2の処理用面1,2を互いに離反させる 力を離反力として説明するものであり、上記の示した力を離反力から排除するも のではない。

[0054]

上述のように、密閉された被処理流動体の流路において、処理用面 1, 2 間の被処理流動体を介し、離反力と、接面圧力付与機構 4 が奏する接面圧力とが均衡した状態を形成することにより、両処理用面 1, 2 間に、所望の微細化の処理を行うのに適した流体膜を形成する。このように、この微細化装置は、処理用面 1, 2 間に強制的に流体膜を介することにより、従来の機械的な微細化装置では、不可能であった微小な間隔を、両処理用面 1, 2 維持するを可能として、高精度な脱気処理を実現したのである。

[0055]

言い換えると処理用面1,2間における流体膜の膜厚は、上述の離反力と接面 圧力の調整により、所望の厚みに調整し、必要とする微細化の処理を行うことが できる。従って、流体膜の厚みを小さくしようとする場合、離反力に対して相対 的に接面圧力が大きくなるように、接面圧力或いは離反力を調整すればよく、逆 に流体膜の厚みを大きくようとすれば、接面圧力に対して相対的に離反力が大き くなるように、離反力或いは接面圧力を調整すればよい。

接面圧力を増加させる場合、接面圧力付与機構4において、エア導入部44から正圧(空気圧)を付与し、又は、スプリング43を押圧力の大きなものに変更 或いはその個数を増加させればよい。

離反力を増加させる場合、流体圧付与機構 p の送り込み圧力を増加させ、或いは第2処理用面2や離反用調整面23の面積を増加させ、またこれに加えて、第2処理用部20の回転を調整して遠心力を増加させ或いはエア導入部44からの負圧(空気圧)を付与すればよい。スプリング43は、伸びる方向に押圧力を発する押し発条としたが、縮む方向に力を発する引き発条として、接面圧力付与機構4の構成の一部又は全部とすることが可能である。

[0056]

さらに、接面圧力及び離反力の増加減少の要素として、上記の他に粘度などの 被処理流動体の性状も加えることができ、このような被処理流動体の性状の調整 も、上記の要素の調整として、行うことができる。

[0057]

なお、離反力のうち、離反側の受圧面(即ち、第2処理用面2及び離反用調整面23)に作用する流体圧は、メカニカルシールにおけるオープニングフォースを構成する力として理解される。

メカニカルシールにあっては、第2処理用部20がコンプレッションリングに相当するが、この第2処理用部20に対して流体圧が加えられた場合に、第2処理用部2を第1処理用部1から離反する力が作用する場合、この力がオープニングフォースとされる。

より詳しくは、上記の第1の実施の形態のように、第2処理用部20に離反側の受圧面(即ち、第2処理用面2及び離反用調整面23)のみが設けられている場合には、送り込み圧力の全てがオープニングフォースを構成する。なお、 第2処理用部20の背面側にも受圧面が設けられている場合(具体的には、後述す

る図2(B)及び図9の場合)には、送り込み圧力のうち、離反力として働くものと接面圧力として働くものとの差が、オープニングフォースとなる。

[0058]

ここで、図2(B)を用いて、第2処理用部20の他の実施の形態について説明する。

図2(B)に示す通り、この第2処理用部20の収容部41より露出する部位であり且つ内周面側に、第2処理用面2と反対側(上方側)を臨む近接用調整面24が設けられている。

即ち、この実施の形態において、接面圧力付与機構4は、収容部41と、エア 導入部44と、上記近接用調整面24とにて構成されている。但し、接面圧力付 与機構4は、上記収容部41と、上記発条受容部42と、スプリング43と、エ ア導入部44と、上記近接用調整面24の少なくとも、何れか1つを備えるもの であればよい。

[0059]

この近接用調整面24は、被処理流体に掛けた所定の圧力を受けて第1処理用面1に第2処理用面2を接近させる方向に移動させる力を発生させ、近接用接面圧力付与機構4の一部として、接面圧力の供給側の役目を担う。一方第2処理用面2(と前述の離反用調整面23と)は、被処理流体に掛けた所定の圧力を受けて第1処理用面1から第2処理用面2を離反させる方向に移動させる力を発生させ、離反力(の一部について)の供給側の役目を担うものである。

近接用調整面24と、第2処理用面2(及び離反用調整面23)とは、共に前述の被処理流動体の送圧を受ける受圧面であり、その向きにより、上記接面圧力の発生と、離反力の発生という異なる作用を奏する。

[0060]

この近接用調整面24の面積A1と、第2処理用部20の第2処理用面2と離 反側受圧面23との合計面積A2との面積比(A1/A2)は、バランス比Kと 呼ばれ、上記のオープニングフォースの調整に重要である。

近接用調整面24の先端と離反側受圧面23の先端とは、共に環状の第2調整 用部20の内周面25 (先端線L1) に規定されている。このため、近接用調整 面24の基端線L2をどこに置くかの決定で、バランス比の調整が行われる。

即ち、この実施の形態において、被処理用流動体の送り出しの圧力をオープニングフォースとして利用する場合、第2処理用面2及び離反用調整面23との合計面積を、近接用調整面24の面積より大きいものとすることによって、その面積比率に応じたオープニングフォースを発生させることができる。

[0061]

上記のオープニングフォースについては、上記バランスライン、即ち近接用調整面24の面積A1を変更することで、被処理流動体圧力(流体圧)により調整できる。

摺動面実面圧P(接面圧力のうち流体圧によるもの)は次式で計算される。

 $P = P 1 \times (K - k) + P s$

ここでP1は、被処理流動体の圧力(流体圧)を示し、Kは上記のバランス比を示し、kはオープニングフォース係数を示し、Psはスプリング及び背圧力を示す。

この (バランスラインの調整により) 摺動面実面圧 P を調整することで処理用面1,2間を所望の微小隙間量(隙間幅)にし被処理流動体による流動体膜を形成させ所望の微細化処理を行うのである。

[0062]

通常、両処理用面1,2間の流体膜の厚みを小さくすれば、被処理物(被処理流動体)をより細かくすることができる。逆に、当該流体膜の厚みを大きくすれば、処理が粗くなり単位時間あたりの処理量が増加する。従って、上記の摺動面実面圧P(以下面圧P)の調整により、両処理用面1,2間の間隔(隙間)を調整して、所望の微細化を行うことができる。

この関係を纏めると、上記の微細化処理を粗くする場合、バランス比を小さくし、面圧Pを小さくし、上記隙間を大きくして、上記膜厚を大きくすればよい。逆に、上記の微細化処理をより細かくする場合、バランス比を大きくし、面圧Pを大きくし、上記隙間を小さくし、上記膜厚を小さくする。

このように、接面圧力付与機構4の一部として、近接用調整面24を形成して 、そのバランスラインの位置にて、接面圧力の調整、即ち処理用面間の隙間を調 整するものとしても実施可能である。

[0063]

上記の隙間の調整には、既述の通り、他に、前述のスプリング43の押圧力や、エア導入部44の空気圧を考慮して行う。また、流体圧即ち被処理流動体の送り圧力の調整や、更に、第1処理用部10(第1ホルダ11)の回転(遠心力)の調整(も、重要な調整の要素(パラメータ)である。

上述の通り、この装置は、第2処理用部20と、第2処理用部20に対して回転する第1処理用部10とについて、被処理流動体の送り込み圧力と当該回転遠心力、また接面圧力で圧力バランスを取り両処理用面に所定の流体膜を形成させ所望のせん断力を被処理流動体に与える構成にしている。またリングの少なくとも一方をフローティング構造とし芯振れなどのアライメントを吸収し接触による磨耗などの危険性を排除している。

[0064]

この図2 (B) の実施の形態においても、上記の調整用面を備える以外の構成については、図1に示す実施の形態と同様である。

また、図2(B)に示す実施の形態において、図9に示すように、上記の離反側受圧面23を設けずに実施することも可能である。この場合、上記のバランス比Kは、近接用調整面24の面積A1と、第2処理用部20の第2処理用面2の面積A2との、面積比(A1/A2)となる。

図2(B)や図9に示す実施の形態のように、近接用調整面24を設ける場合、近接用調整面24の面積A1を上記の面積A2よりも大きいものとすること、即ちメカニカルシールにおけるアンバランス型とすることにより、オープニングフォースを発生させずに、逆に、被処理流動体に掛けられた所定の圧力は、全て接面圧力として働くことになる。このような設定も可能であり、この場合、他の離反力を大きくすることにより、両処理用面1,2を均衡させることができる。

[0065]

上記の実施の形態において、既述の通り、スプリング43は、摺動面(処理用面)に均一な応力を与える為に、取付け本数は、多いほどよい。但し、このスプリング43については、図3(A)へ示すように、シングルコイル型スプリング

を採用することも可能である。これは、図示の通り、中心を環状の第2処理用部 20と同心とする1本のコイル型スプリングである。

第2処理用部20と第2ホルダ21との間のシールには、既述の通り〇リングを用いるのがよいが、このような〇リングに代え、或いは〇リングと共に、図3(B)へ示すベローズ26や、図3(C)へ示すダイアフラム27を設けても実施可能である。

[0066]

図4に示すように、第2ホルダ21には、第2処理用面2(第2処理用部20)とを、冷却或いは加熱して、その温度を調整することが可能な温度調整用ジャケット46が設けられている。また、ケース3にも、同様の目的の温度調整用ジャケット35が設けられている。

第2ホルダ21の温度調整用ジャケット46は、第2ホルダ21内において、 収容部41の側面に形成された水回り用の空間であり、第2ホルダ21の外部に 通じる通路47,48と連絡している。通路47,48は、何れか一方が温度調 整用ジャケット46に、冷却用或いは加熱用の媒体を導入し、何れか他方が当該 媒体を排出する。

また、ケース3の温度調整用ジャケット35は、ケース3の外周を被覆する被 覆部34にて、ケース3の外周面と当該被覆部34との間に設けられた、加熱用 水或いは冷却水を通す通路である。

この実施の形態では、第2ホルダ21とケース3とが、上記の温度調整用のジャケットを備えるものとしたが、第1ホルダ11にも、このようなジャケットを 設けて実施することが可能である。

[0067]

接面圧力付与機構4の一部として、図1及び図2に示す構成と共に、図5に示すシリンダ機構7を設けて実施することも可能である。

このシリンダ機構7は、第2ホルダ21内に設けられたシリンダ空間部70と、シリンダ空間部70を収容部41と連絡する連絡部71と、シリンダ空間部70内に収容され且つ連絡部71を通じて第2処理用部20と連結されたピストン体72と、シリンダ空間部70上部に連絡する第1ノズル73と、シリンダ空間

部70下部に第2ノズル74と、シリンダ空間部70上部とをピストン体72と の間に介された発条などの押圧体75とを備えたものである。

[0068]

ピストン体72は、シリンダ空間部70内にて上下に摺動可能であり、ピストン体72の当該摺動にて第2処理用部20が上下に摺動して、第1処理用面1と第2処理用面2との間の隙間を変更することができる。

具体的には、コンプレッサなどの圧力源(図示せず。)と第1ノズル73とを接続し、第1ノズル73からシリンダ空間部70内のピストン体72上方に空気圧(正圧)を掛けることにて、ピストン体72を下方に摺動させ、第2処理用部20を第1及び第2処理用面1,2間の隙間を狭める(閉じる方向に移動させる)ことができる。またコンプレッサなどの圧力源(図示せず。)と第2ノズル74とを接続し、第2ノズル74からシリンダ空間部70内のピストン体72下方に空気圧(正圧)を掛けることにて、ピストン体72を上方に摺動させ、第2処理用部20を第1及び第2処理用面1,2間の隙間を広げる(開く方向に移動させる)ことができる。このように、ノズル73,74にて得た空気圧で、接面圧力を調整できるのである。

[0069]

[0070]

収容部41内における第2処理用部20の上部と、収容部41の最上部との間に余裕があっても、ピストン体7がシリンダ空間部70の最上部70aと当接するよう設定することにより、このシリンダ空間部70(の最上部70a)が、両処理用面1,2間の隙間の幅の上限を規定する。即ち、ピストン体7とシリンダ空間部70の最上部70aとが、両処理用面1,2の離反を抑止する離反抑止部(両処理用面1,2間の隙間の最大開き量を規制する機構)として機能する。

また、両処理用面1,2とが当接していなくても、ピストン体7がシリンダ空間部70の最下部70bと当接するよう設定することにより、このシリンダ空間部70(の最下部70b)が、両処理用面1,2間の隙間の幅の下限を規定する。即ち、ピストン体7とシリンダ空間部70の最下部70bとが、両処理用面1,20近接を抑止する近接抑止部(両処理用面1,2間の隙間の最小開き量を規

制する機構)として機能する。

このように上記隙間の最大及び最小の開き量を規制しつつ、ピストン体7とシリンダ空間部70の最上部70aとの間隔 z 1 (換言するとピストン体7とシリンダ空間部70の最下部70bとの間隔 z 2)を上記ノズル73,74の空気圧にて調整する。

[0071]

ノズル73,74は、別個の圧力源に接続されたものとしてもよく、一つの圧力源を切り換えて(つなぎ換えて)接続するものとしてもよい。

また圧力源は、正圧を供給するものでも負圧を供給するものでも何れでも実施可能である。真空などの負圧源と、ノズル73,74とを接続する場合、上記の動作は反対になる。

前述の他の接面圧力付与機構4に代え或いは前述の接面圧力付与機構4の一部として、このようなシリンダ機構7を設けて、被処理流動体の粘度や性状によりノズル73,74に接続する圧力源の圧力や間隔 z 1, z 2 の設定を行い流動体液膜の厚みを所望値にしせん断力をかけ微細化を行うことができる。特に、このようなシリンダ機構7にて、洗浄時や蒸気滅菌時など摺動部の強制開閉を行い洗浄や滅菌の確実性を上昇させることも可能とした。

[0072]

図6(A)~(C)に示すように、第1処理用部10の第1処理用面1に、第1処理用部10の中心側から外側に向けて(径方向について伸びる)溝状の凹部13…13を形成して実施してもよい。この場合、図6(A)へ示すように、凹部13…13は、第1処理用面1上をカーブして或いは渦巻き状伸びるものとして実施可能であり、図6(B)へ示すように、個々の凹部13がL字状に屈曲するものであっても実施可能であり、また、図6(C)に示すように、凹部13…13fは真っ直ぐ放射状に伸びるものであっても実施可能である。

[0073]

また、図6(D)へ示すように、図6(A)~(C)の凹部13は、第1処理 用面1の中心側に向かう程深いものとなるように勾配をつけて実施するのが好ま しい。また、溝状の凹部13は、連続したものの他、断続するものであっても実 施可能である。

この様な凹部13を形成することにより被処理流動体の吐出量(供給量)の増加または発熱量の減少への対応や、キャビテーションコントロールや流体軸受けなど効果がある。

上記の図6に示す各実施の形態において、凹部13は、第1処理用面1に形成するものとしたが、第2処理用面2に形成するものとしても実施可能であり、更には、第1及び第2の処理用面1,2の双方に形成するものとしても実施可能である。

[0074]

処理用面に、上記の凹部13やテーパを設けない場合、若しくは、これらを処理用面の一部に偏在させた場合、処理用面1,2(平滑部)の面粗度が被処理流動体(流体)に与える影響は、上記(凹部13を形成するもの)に比して、大きいものとなる。従って、このような場合、被処理流動体(流体)の粒子が小さくなればなるほど、面粗度を下げる(きめの細かいものとする)必要がある。特にナノサイズの超微化を行う場合その処理用面の面粗度については、既述の鏡面(鏡面加工を施した面)とするほうが所望のせん断力を与える上で有利である。

[0075]

図7に示すように、導入部22とは別に、第2処理用部20に第2処理用面2 に開口する供給通路28を設け、当該供給通路28を通じて他より、第1処理用面1と第2処理用面2との間の被処理流動体(流体)に直接違った物質または、被分断流動体の一部を投入するものとしても実施可能である。

[0076]

図1に示す実施の形態において、不動の第2処理用部20(第2ホルダ21)に対して、第1処理用部10(第1ホルダ11)が回転駆動装置5より回転力を受けて回転するものであった。この他、図8に示すように、第2ホルダ21を、別途の副回転駆動装置52へ別途の回動軸53(以下副回動軸53と呼ぶ。)を介して接続して、第1ホルダ11と逆方向に回転させるものとしても、より大きな剪断力を得る上で、効果的である。

この場合、前述の回転軸50と上記の副回転軸53とは、同心に配置される。

そして。被処理流動体(流体)の導入部22は、副回転駆動装置52の内部及び副回転軸53に設けられた中空の通路として形成され、ロータリージョイント(図示せず。)を利用して、被処理流動体(流体)を、副回転駆動装置52の反対側(上方)より、第2処理用部20の中心へ放出する。このようにケース3内に導入されて両処理用面1,2間にて処理された被処理流動体は、排出部32より外部へ排出される。

[0077]

この図8に示す装置では、回転速度を上げて大きなせん断力を得ようとする場合、極めて有効である。またこの場合、第1ホルダ11と第2ホルダ21の回転の速さ(回転数)は、同じとしても、異なるものとしても何れでも実施可能である。

この図8に示す実施の形態では、攪拌用羽根6は、設けていない。

[0078]

図3万至図8に示す実施の形態においても、特に明示した以外の構成について は図1又は図2に示す実施の形態と同様である。

図1に示す実施の形態では、プレ分散を目的とする攪拌羽根6を有するものを 示したが、この他、プレ分散としない場合は、このような攪拌羽根6を持たない ものとしても実施可能である(図示しない)。

[0079]

また、上記各実施の形態において、被処理流動体は、環状の第2処理用部2或いは第1処理用部10の内側から外側に移動するものとした。この他、処理される被処理流動体を第2処理用部2或いは第1処理用部10の外部からその内部へ移動させることによって、第1処理用面1と第2処理用面2との間を通過させるものとしてもよい(図示しない)。例えば、図1に示す装置の排出部を導入部として、導入部を排出部とするように変更して実施することも可能である。この場合、図1に示す排出部側から加圧する。但し、図1に示す導入部側から負圧で吸引するものとしても実施可能である。

[0080]

このように、被処理流動体の移動を、第2処理用部2或いは第1処理用部10

の外部からその内部へ向けて行う場合、図6(E)に示すように、第1処理用部 10の第1処理用面1に、第1処理用部10の外側から中心側に向けて伸びる溝 状の凹部13…13を形成して実施することも可能である。このような図6(E)に示す凹部13…13を形成することにより、前述のバランス比については、 100%以上のアンバランス型とするのが好ましい。この結果、回転時に、上記 の溝状の凹部13…13に動圧が発生し、両処理用面1,2は確実に非接触で回転でき、接触による磨耗などの危険がなくなる。

この図6(E)に示す実施の形態において、被処理流体の圧力による離反力は、凹部13の内端13aにて発生する。

[0081]

また、上記の各実施の形態において、ケース3内は全て密封されたものとしたが、この他、第1処理用部10及び第2処理用部20の内側のみ密封され、その外側は開放されたものとしても実施可能である。即ち、第1処理用面1及び第2処理用面2との間を通過するまでは流路は密封され、被処理流動体は送圧を全て受けるものとするが、通過後は、流路は開放され処理後の被処理流動体は送圧を受けないものとしてもよい。

加圧装置は、既述のとおり、コンプレッサを用いて実施するのが好ましいが、 常に被処理流動体に所定の圧力を掛けることが可能であれば、他の手段を用いて 実施することも可能である。例えば、被処理流動体の自重(重力)を利用して、 常に一定の圧力を被処理流動体に付与するものとしても実施可能である。

[0082]

上記の各実施の形態における微細化装置について総括すると、被処理流動体に 所定の圧力を付与し、この所定の圧力のを受けた被処理流動体が流される密封された流体流路に、第1処理用面1及び第2処理用面2の少なくとも2つの接近離 反可能な処理用面を接続し、両処理用面1,2を接近させる接面圧力を付与し、 第1処理用面1と第2処理用面2とを相対的に回転させることにより、メカニカ ルシールにおいてシールに利用される流体膜を、被処理流動体を用いて発生させ、 メカニカルシールと逆に(流体膜をシールに利用するのではなく)、当該流体 膜を第1処理用面1及び第2処理用面2の間から敢えて漏らして、微細化の処理 を、両面間1,2にて膜とされた被処理流動体に施し、回収することを特徴とするものである。

このような画期的な微細化処理の方法により、両処理用面 1 , 2 間の間隔を 1 μ から 1 mmとする調整、特に、 $1\sim1$ 0 μ とする調整を可能とした。

[0083]

上記の実施の形態において、装置内は密閉された流体の流路を構成するものであり、被処理流動体(被処理物)を、脱気機の導入部側に設けた流体圧付与機構pにて、被処理流動体は加圧されたものであった。

この他、このような流体圧付与機構 p を用いて加圧するものではなく、被処理 流動体の流路は開放されたものであっても実施可能である。

図10万至図13へ、そのような微細化装置付脱気機の一実施の形態を示す。 図10は脱気機の略縦断面図である。図11は、その一部切欠要部略縦断面図で ある。図12は、図10に示す微細化装置が備える第1処理用部材1の平面図で ある。図13は、上記脱気機の第1及び第2処理用部材1,2の一部切欠要部略 縦断面図である。

[0084]

この図10万至図13に示す脱気機は、上記の通り、大気圧下で、脱気処理の対象となる流体(以下、上述してきた被処理流動体を、必要に応じて、このように単に「流体」と呼ぶ。)或いはこのような処理の対象物を搬送する流体が投入されるものである。

図10に示す通り、この脱気機は、微細化装置Gと、減圧ポンプQとを備えたものである。この微細化装置Gは、回転部材である第1処理用部材101と、当該処理用部材101を保持する第1ホルダ111と、固定部材である第2処理用部材102と、当該第2処理用部材102が固定された第2ホルダ121と、付勢機構103と、動圧発生機構104と、第1ホルダ111と共に第1処理用部材101を回転させる駆動部105と、ハウジング106と、流体を供給(投入する)する導入部107と、流体を減圧ポンプQへ排出する排出部108とを備える。

[0085]

上記の第1処理用部材101と第2処理用部材102は、夫々、円柱の中心を くり抜いた形状の環状体である。両処理用部材101,102は、両処理用部材 101,102の夫々が呈する円柱の一底面を処理用面110,120とする部 材である。

上記の処理用面110,120は、鏡面研磨された平坦部を有する。この実施の形態において、第2処理用部材102の処理用面120は、面全体に鏡面研磨が施された平坦面である。また、第1処理用部材101の処理用面110は、面全体を第2処理用部材102と同様の平坦面とするが、図3へ示す通り、平坦面中に、複数の溝112…12を有する。この溝112…12は、第1処理用部材101が呈する円柱の中心を中心側として円柱の外周方向へ、放射状に伸びる。

上記の第1及び第2の処理用部材101,102の処理用面110,120についての、鏡面研磨は、面粗度Ra0.01~1.0μmとするのが好ましい。 この鏡面研磨について、Ra0.03~0.3μmとするのがより好ましい。

処理用部材101,102の材質については、硬質且つ鏡面研磨が可能なものを採用する。処理用部材101,102のこの硬さについて、少なくともビッカース硬さ1500以上、望ましくはビッカース硬さ1800以上とする。また、線膨張係数が小さい素材を、採用するのが好ましい。微細化処理にて熱を発する部分と他の部分との間で、膨張率の差が大きいと歪みが発生して、適正なクリアランスの確保に影響するからである。

このような処理用部材101,102の素材として、特に、SIC(シリコンカーバイト/ビッカース硬さ2000~2500)、表面にDLC(ダイヤモンドライクカーボン/ビッカース硬さ3000~4000)コーティングが施されたSIC、WC(タングステンカーバイト/ビッカース硬さ1800)、表面にDLCコーティングが施されたWC、ZrB2やBTC,B4Cに代表されるボロン系セラミック(ビッカース硬さ4000~5000)などを採用するのが好ましい。

[0086]

ハウジング106は、有底の筒状体であり、上方が上記の第2ホルダ121に 覆われている。第2ホルダ121は、下面に上記第2処理部材102が固定され ており、上方に上記導入部7が設けられている。導入部107は、外部から流体 や被処理物を投入するためのホッパ170を備える。

上記の駆動部105は、電動機などの動力源(図示せず。)と、当該動力源から動力の供給を受けて回転するシャフト150とを備える。

上記回転は、第1処理用部材101の直径を100mmとした場合毎分2万回転、第1処理用部材101の直径を200mmとした場合毎分1万回転、第1処理用部材101の直径を400mmとした場合毎分5千回転である。即ち、第1処理用部材101の回転時の周速度という観点では、約6300メートル毎分であり、これは、処理用面110と処理用面120のドライコンタクトを防止できるために可能となったのである。

図10に示すように、シャフト150は、ハウジング106の内部に配され上下に伸びる。そして、シャフト150の上端部に上記の第1ホルダ111が、設けられている。第1ホルダ111は、第1処理用部材101を保持するものであり、上記の通りシャフト150に設けられることにより、第1処理用部材101の処理用面110を第2処理用部材102の処理用面120に対応させる。

[0087]

第1ホルダ111は、円柱状体であり、上面中央に、第1処理用部材101が 固定されている。第1処理用部材101は、第1ホルダ111と一体となるよう に、固着され、第1ホルダ111に対してその位置を変えない。

一方、第2ホルダ121の上面中央には、第2処理用部材102を受容する受容型部124が形成されている。

上記の受容凹部124は、環状の横断面を有する。第2処理用部材102は、 受容凹部124と、同心となるように円柱状の受容凹部124内に収容される。 【0088】

詳しくは、上記の受容凹部124内には、第2処理用部材102と別体の環状体123が収容される。受容凹部124の底面(天部124a)には、突起物127(ピン)が設けられている。環状体123の上記天部124aを臨む面(上面)には、この突起物127を収容することが可能な凹部126が設けられている。突起物127は、環状体123の第2ホルダ121に対する回り止めである

。突起物127は、凹部126内に余裕(遊び)を持つように収容される。

この環状体123の、受容凹部124の天部124aと反対側(下方)に、第2処理用部材102が収容される。環状体123の天部124aと反対側の面(下面)には、突起物125(ピン)が設けられている。第2処理用部材102の研磨用面120と反対側の面には、上記突起物125を収容する凹部122が設けられている。突起物125は、環状体123に対する第2処理用部材102の回り止めである。突起物125は、凹部122内に余裕(遊び)を持つように収容される。

[0089]

そして、この第2ホルダ121が、上記の付勢機構103を備える。付勢機構103は、ゴム製のOリングやバネなどの弾性体を用いるのが好ましい。具体的には、この実施の形態において、上記の環状体123について、その(上下)両端面間に複数の貫通孔131…131が設けられており、この貫通孔131…131に、付勢機構103となる複数のバネ130…130が収容される。これにて、第2処理用部材102の上面(処理用面120と反対側の面)と、受容凹部124の底(天面124a)との間に、第2処理用部材102を第1処理用部材101に向けて付勢する付勢機構103が介される。即ち、バネ130…130は、第2処理用部材101側(下方)に第2処理用部材102を付勢する。上記のバネ130…130は、受容凹部124の底124a上において、偏りなく分布する

付勢機構103にバネを採用する場合、上記の通り複数のバネを用意するのに代え、第2処理用部材102の内周面の内径よりも大きく且つ第2処理用部材102の外径よりも小さな径を有するバネを一つ用意することによっても実施することができる。付勢機構103は、第2処理用部材102の処理用面120と反対側の面(図10及び図11において第2処理用部材102の上面)の各部に、偏りなく均一な付勢力を掛けることが可能なものであればよく、上記のバネに限定するものではない。

即ち、上記において、付勢機構103は、バネ131のみにて構成されたもの

としたが、この他、付勢機構103は、上記のバネ131に代え、或いはバネ1 31と共に、空気などの流体圧を利用した付勢手段を用いて実施することも可能 である。

具体的には、図10に示すように、付勢機構103の一部として、高圧空気導入口132を設けて、付勢力の調整を行うものとしても実施可能である。この場合、付勢機構103は、高圧空気導入口132のみにて構成するものであってもよく、また、図10に示す通り、バネ131と高圧空気導入口132とによって構成するものであってもよい。

[0090]

一方、受容凹部124の内径は、第2処理用部材102の外径よりも大きく、これにて、上記の通り同心に配設した際、第2処理用部材102の外周面102 bと受容凹部124の内周面との間には、図11に示すように、隙間t1が設定される。

同様に、第2処理用部材102の内周面102aと受容凹部124の中心部外 周面との間には、図11に示すように、隙間t2が設定される。

上記隙間 t 1、 t 2 の夫々は、振動や偏芯挙動を吸収するためのものであり、動作寸法以上確保され且つシールが可能となる大きさに設定する。例えば、第 1 処理用部材 1 0 1 の直径が 1 0 0 mmから 4 0 0 mmの場合、当該隙間 t 1、 t 2 の夫々は、0. 1 \sim 0. 3 mmとするのが好ましい。

第1ホルダ111は、その内ホルダ115と共に、シャフト150へ一体に固定され、シャフト150と共に回転する。また、上記の突起物125,127によって、環状体123を介しても、第2ホルダ121に対して、第2処理用部材102は回らない。しかし、両処理用面110,120間に、微細化処理に必要な0.1~10ミクロンの微小な間隔t(クリアランス/図13(B)参照)を確保するため、受容凹部124の底面(天部124a)と環状体123の上記天部124aを臨む面(上面)と間に隙間t3が設けられる。この隙間t3については、上記のクリアランスと共に、シャフト150の振れや伸びを考慮して設定する。

[0091]

即ち、この実施の形態において、付勢機構103と、上記隙間 t 1~t 3とが、フローティング機構を構成し、このフローティング機構によって、少なくとも第2処理用部材102の中心や傾きを、数ミクロンから数ミリの程度の僅かな量、可変としている。これにて、回転軸の芯振れ、軸膨張、第1処理用部材101の面振れ、振動を吸収する。

尚、上記突起物125と凹部122の間、及び突起物127と凹部126との間の遊びによって、第2処理用部材102の上記フローティング機構の動作は、確保され、これらの回り止めの機構に、当該動作が阻害されない。

[0092]

第1処理用部材101の研磨用面110が備える前記の溝112について、更に詳しく説明する。溝112の後端は、第1処理用部材101の内周面101aに達するものであり、その先端を第1処理用部材101の外側y(外周面側)に向けて伸ばす。この溝112は、図12(A)へ示すように、その横断面積を、環状の第1処理用部材101の中心x側から、第1処理用部材101の外側y(外周面側)に向かうにつれて、漸次減少するものとしている。

溝112の左右両側面112a,112bの間隔w1は、第1処理用部材101の中心x側から、第1処理用部材101の外側y(外周面側)に向かうにつれて小さくなる。また、溝112の深さw2は、図12(B)へ示すように、第1処理用部材101の中心x側から、第1処理用部材101の外側y(外周面側)に向かうにつれて、小さくなる。即ち、溝112の底112cは、第1処理用部材101の中心x側から、第1処理用部材101の外側y(外周面側)に向かうにつれて、浅くなる。

このように、溝112は、その幅及び深さの双方を、外側y(外周面側)に向かうにつれて、漸次減少するものとして、その横断面積を外側yに向けて漸次減少させている。そして、溝112の先端(y側)は、行き止まりとなっている。即ち、溝112の先端(y側)は、第1処理用部材101の外周面101bに達

するものではなく、溝112の先端と外周面101bとの間には、外側平坦面1 13が介在する(この外側平坦面113は、処理用面110の一部である)。

この実施の形態において、このような溝112の左右両側面112a, 112 bと底112cとが流路制限部を構成している。この流路制限部と、第1処理用部材101の溝112周囲の平坦部と、第2処理用部材102の平坦部とが、動圧発生機構104を構成している。

但し、溝112の幅及び深さの何れか一方についてのみ、上記の構成を採るものとして、断面積を減少させるものとしてよい。その場合、上記の構成を採らない、左右両側面112a,112b或いは底112cは、流路制限部とならず、動圧発生機構104の構成要素とならない。

上記の動圧発生機構104は、第1処理用部材101の回転時、両処理用部材101,102間を通り抜けようとする流体によって、両処理用部材101,102の間に所望の微小間隔を確保することを可能とする、両処理用部材101,102を離反させる方向に働く力を発生させる。このような動圧の発生により、両処理用面110,120間に、0.1~10μmの微小間隔を発生させることができる。このような微小間隔は、処理の対象によって、調整し選択すればよいのであるが、1~6μmとするのが好ましく、より好ましくは、1~2μmである。この脱気機においては、上記のような微小間隔による従来にない微細な気泡等の脱泡等の処理が可能である。

[0093]

溝112…112の夫々は、真っ直ぐ、中心×側から外側yに伸びるものであっても実施可能である。但し、この実施の形態において、図12(A)に示すように、第1処理用部材101の回転方向rについて、溝112の中心×側が、溝112の外側yよりも、先行するように(前方に位置するように)、湾曲して溝112を伸びるものとしている。

このように溝112…112が湾曲して伸びることにより、動圧発生機構10 4による離反力の発生をより効果的に行うことができる。

[0094]

次に、この脱気機の動作について説明する。

導入部107(ホッパ170)から投入された、被処理物である流体Rは、環状の第2処理用部材102の中空部(中央)を通り、第1処理用部材101の回転よる遠心力を受けた流体は、両処理用部材101,102間に入り、回転する第1処理用部材101の処理用面110と、第2処理用部材102の処理用面120との間にて、微細化の処理が行われ、その後、両処理用部材101,102の外側に出て、排出部108から減圧ポンプQ側へ排出される。

上記において、環状の第2処理用部材102の中空部に入った流体Rは、図13(A)へ示すように、先ず、回転する第1処理用部材101の溝112に入る。一方、鏡面研磨された(平坦部である)両処理用面110,120は、空気や窒素などの気体を通しても気密性が保たれている。従って、回転による遠心力を受けても、そのままでは、付勢機構103によって、押し合わされた両処理用面110,120の間に、溝112から流体は入り込むことはできない。しかし、流路制限部として形成された溝112の上記両側面112a,112bや底112cに、流体Rは徐々に突き当たり、両処理用面110,120を離反させる方向に働く動圧を発生させる。これによって、流体Rが溝112から平坦面に滲み出し、両処理用面110,120の間に微小間隔(クリアランス)を確保することができる。そして、このような鏡面研磨された平坦面の間で、微細化の処理が行われる。また上述の溝112の湾曲が、より確実に流体へ遠心力を作用させ、上記動圧の発生をより効果的にしている。

このように、この脱気機は、動圧と付勢機構103による付勢力との均衡にて、両鏡面(処理用面110, 120)間に、微細な間隔(クリアランス)を確保することを可能とした。そして、上記の構成により、当該微細間隔は、 1μ m以下の超微細なものとすることができる。

また、上記フローティング機構の採用により、処理用面110,120間のアライメントの自動調整が可能となり、回転や発生した熱による各部の物理的な変形に対して、処理用面110,120間の各位置における、クリアランスのばらつきを、抑制し、当該各位置における上記の小間隔の維持を可能とした。

[0095]

尚、上記の実施の形態において、フローティング機構は、第2ホルダ121に

のみ設けられた機構であった。この他、第2ホルダ121に代え、或いは第2ホルダ121と共に、フローティング機構を、第2ホルダ121にも設けるものとして実施することも可能である。

[0096]

図14乃至図16に、上記の溝112について、他の実施の形態を示す。

図14(A)(B)に示すように、溝112は、流路制限部の一部として、先端に平らな壁面112dを備えるものとして実施することができる。また、この図14に示す実施の形態では、底112cにおいて、第1壁面112dと、内周面101aとの間に段差112eが設けられており、この段差112eも流路制限部の一部を構成する。

図15(A)(B)に示すように、溝112は、複数に分岐する枝部112f …112f を備えるものとし、各枝部112f がその幅を狭めることにより流路 制限部を備えるものとしても実施可能である。

図14及び図15の実施の形態においても、特に示した以外の構成については 、図10乃至図13に示す実施の形態と同様である。

[0097]

また、上記の各実施の形態において、溝112の幅及び深さの少なくとも何れか一方について、第1処理用部材101の内側から外側に向けてその寸法を漸次小さくすることにて、流路制限部を構成するものとした。この他、図16(A)や図16(B)へ示す通り、溝112の幅や深さを変化させずに、溝112に終端面112 f を設けることによって、このような溝112の終端面112 f を流路制限部とすることができる。図12、図14及び図15に示す実施の形態において示した通り、動圧発生は、溝112の幅及び深さを既述の通り変化させることによって溝112の底や両側面を傾斜面とすることで、この傾斜面が流体に対する受圧部になり動圧を発生させた。一方図16(A)(B)に示す実施の形態では、溝112の終端面が流体に対する受圧部になり動圧を発生させる。

また、この図16(A)(B)に示す場合、溝112の幅及び深さの少なくと も何れか一方の寸法を漸次小さくすることも併せて実施することができる。

尚、溝112の構成について、上記の図12、図14乃至図16に示すものに

限定するものではなく、他の形状の流路制限部を備えたものとして実施すること が可能である。

例えば、図12、図14乃至図16示すものでは、溝112は、第1処理用部材101の外側に突き抜けるものではなかった。即ち、第1処理用部材101の外周面と、溝112との間には、外側平坦面113が存在した。しかし、このような実施の形態に限定するものではなく、上述の動圧を発生されることが可能であれば、溝112は、第1処理用部材101の外周面側に達するものであっても実施可能である。

例えば、図16(B)に示す第1処理用部材101の場合、点線で示すように、溝112の他の部位よりも断面積が小さな部分を、外側平坦面113に形成して実施することができる。

また、溝112を、上記の通り内側から外側へ向けて漸次断面積を小さくするように形成し、溝112の第1処理用部材101の外周に達した部分(終端)を、最も断面積が小さいものとすればよい(図示せず)。但し、動圧を効果的に発生させる上で、図12、図14乃至図16に示すように、溝112は、第1処理用部材101の外周面側に突き抜けないほうが好ましい。

[0098]

上記の各実施の形態では、第1処理用部材101のみが回転し、第2処理用部材102は、回転しないものとした。この他、第1処理用部材101のみならず、第2処理用部材102も回転するものとしても実施可能である。この場合、第2処理用部材102は、第1処理用部材101の回転方向rに対し、逆方向に回転するものとする。

このような脱気機として、例えば、図17に示すように、既述の駆動部105 とは別個の、シャフト150aを備えた駆動部105aを設けて、ハウジング1 06と独立して形成された第2ホルダ121を回転させればよい。この場合、駆動部5aのシャフト150aを中空として、このシャフト150内部を導入部1 07とする。

図17に示す脱気機では、図10及び図11に示す脱気機と同様、フローティング機構は、第2ホルダ121が備えるものである。この他、第2ホルダ121

に代え或いは第2ホルダ121と共に第1ホルダ111もフローティング機構を 備えるものとしても実施可能である。

[0099]

ここで、上記図10乃至図17に示す各実施の形態について、総括する。

この脱気機は、平坦処理用面を有する回転部材と同じく平坦処理用面を有する固定部材とをそれらの平坦処理用面で同心的に相対向させ、回転部材の回転下に固定部材の開口部より被粉砕原料を供給しながら両部材の対向平面処理用面間より該被粉砕原料を微細化して処理する脱気機において機械的にクリアランスを調整するのではなく、回転部材に増圧機構を設けてその圧力発生によりクリアランスを保持しかつ機械的クリアランス調整では、不可能であった1~6μmの微小クリアランスを可能とし微細化能力が著しく向上出来たものである。

即ち、この脱気機は、回転部材と固定部材がその外周部に平坦処理用面を有しその平坦処理用面において、面上の密封機能を有することで流体静力学的(ハイドロスタティック)一流体動力学的(ハイドロダイナミック)な力、或いは、エアロスタティックーエアロダイナミックな力を発生させる高速回転式の脱気機を提供しようとするものである。上記の力は、上記密封面間に僅かな間隙を発生させ、また非接触で機械的に安全で高度な微細化機能を有した脱気機を提供することができる。この僅かな隙間が形成されうる要因は、一つは、回転部材の回転速度によるものであり、もう一つは、被処理物(流体)の投入側と排出側の圧力差によるものである。投入側に圧力付与機構が付設されている場合は、投入側に圧力付与機構が付設されている場合は、投入側に圧力付与機構が付設されている場合は、投入側に圧力付与機構が付設されていない場合即ち大気圧下で被処理物(流体)を投入される場合、圧力差が無いわけであるから回転部材の回転速度だけで密封面間の分離を生じさせる必要がある。これは、ハイドロダイナミックもしくはエアロダイナミック力として知られている。

[0100]

減圧ポンプQ(図10)を上記微細化装置Gの排出部に接続したものを示したが、既述の通りハウジング106(ケース3)を設けず、また減圧ポンプQを設けずに、図18(A)に示すように脱気機を減圧用のタンクTとして、当該タンクTの中に、微細化装置Gを配設することにて実施することが可能である。

この場合、タンクT内を真空或いは真空に近い状態に減圧することにて、微細化装置Gにて微細化された被処理物をタンクT内に霧状に噴射せしめ、タンクTの内壁にぶつかって流れ落ちる被処理物を回収すること、或いはこのような流れ落ちる被処理物に対して気体(蒸気)として分離されタンクT内上部に充満するものを回収することにて、処理後の目的物を得ることができる。

また、減圧ポンプQを用いる場合も、図18(B)へ示すように、微細化装置 Gに、減圧ポンプQを介して、気密なタンクTを接続することにより、当該タン クT内にて、処理後の被処理物を霧状にして、目的物の分離(抽出)を行うこと ができる。

更に、図18(C)へ示すように、減圧ポンプQを直接微細化装置Gに接続し、当該タンクTに、減圧ポンプQと、減圧ポンプQとは別の流体Rの排出部とを接続して、目的物の分離を行うことができる。この場合、気化部については、減圧ポンプQに吸いよせられ、液体R(液状部)は排出部より、気化部とは別に排出される。

[0101]

【発明の効果】

本願第1乃至21の発明の実施によって、微細化のために、従来のパンチング プレートやメッシュという構成を排除して、これら部材の面倒な洗浄という作業 を不要とした。そして、パンチングプレートやメッシュでは、不可能であった微 細な気泡の抽出(排除)を可能とした。

特に、本願第4乃至第8の発明の実施によって、被粉砕原料を流体とし、或いは被粉砕原料を流体中に投入する場合において、上下二枚の部材(処理用部材)のクリアランスを15μm以下にすることを実現した。

また、本願第9~21の発明の実施によって、不純物の混入がなく、被処理流動体の適応粘度域が広く且つ被処理流動体に対して大きなせん断力を与えられると共に、高い精度で微細化が可能な脱気機及び脱気方法を提供することを可能とし、高精度で微細化が出来しかも生産性の高い、シンプルな構造の脱気機及び脱気方法を提供し得た。

即ち、メカニカルシールにおける軸封の機構を、微細化のための手段として利

用することにより、高精度で微細化が出来しかも生産性の高い、シンプルな構造の脱気機及び脱気方法を提供し得た。特にこの発明の実施によって、被処理流動体の送り込み圧力(流体圧)や、コンプレッションリング(第2処理用部)の背圧またメイティングリング(第1処理用部)の回転などで被処理流動体の粘度域に制限を受けず、被処理流動体膜の厚みを微小量から調整でき、従来の装置では、不可能であった数nm(ナノメートル)程度の微細化をも可能としかつ、微振動やアライメント、軸方向変位など緩衝装置を設けているため不純物など発生無くして高度な微細化状態を得ることが出来る。また簡単な機構であるため、装置の制御に熟練を要せず、無人化、自動化も容易であり、装置は安定稼動し生産性が高く安価に製作できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本願発明の一実施の形態に係る装置の一部切欠縦断面図である。

【図2】

(A)は上記装置の要部略縦断面図であり、(B)は他の実施の形態の要部略 縦断面図である。

【図3】

(A) は更に他の実施の形態の要部略縦断面であり、(B) は又他の実施の形態の要部略縦断面図であり、(C) は又更に他の実施の形態の要部略縦断面図である。

【図4】

更に又他の実施の形態の要部略縦断面図である。

【図5】

又他の実施の形態の要部略縦断面図である。

【図6】

(A) は更に他の実施の形態の要部略横断面であり、(B) は又他の実施の形態の要部略横断面図であり、(C) は又更に他の実施の形態の要部略横断面図であり、(D) は又他の実施の形態の一部切欠要部略縦断面図であり、(E) は更に他の実施の形態の要部略横断面である。

【図7】

更に他の実施の形態の要部略縦断面図である。

【図8】

又更に他の実施の形態の縦断面図である。

【図9】

又更に他の実施の形態の要部略縦断面図である。

【図10】

本願発明の、更に他の実施の形態に係る脱気機の一部切欠縦断面図である。

【図11】

図10に示す脱気機の、第1処理用部材1及び第1ホルダ11を中心とする要 部略縦断面図である。

【図12】

(A) は図10に示す上記脱気機の第1処理用部材1の平面図であり、(B) はその要部縦断面図である。

【図13】

(A) は図10に示す脱気機の第1及び第2処理用部材1,2の要部縦断面図であり、(B) は微小間隔が開けられた上記第1及び第2処理用部材1,2の要部縦断面図である。

【図14】

(A) は第1処理用部材1の他の実施の形態の平面図であり、(B) はその要部略縦断面図である。

【図15】

(A) は第1処理用部材1の、更に他の実施の形態の平面図であり、(B) はその要部略縦断面図である。

【図16】

(A) は第1処理用部材1のまた他の実施の形態の平面図であり、(B) は第1処理用部材1の更にまた他の実施の形態の平面図である。

【図17】

脱気機の他の実施の形態を示す一部切欠略縦断面図である。

【図18】

(A) (B) (C) は、夫々、微細化後の被処理物の分離方法について、蒸気 以外の実施の形態を示す説明図である。

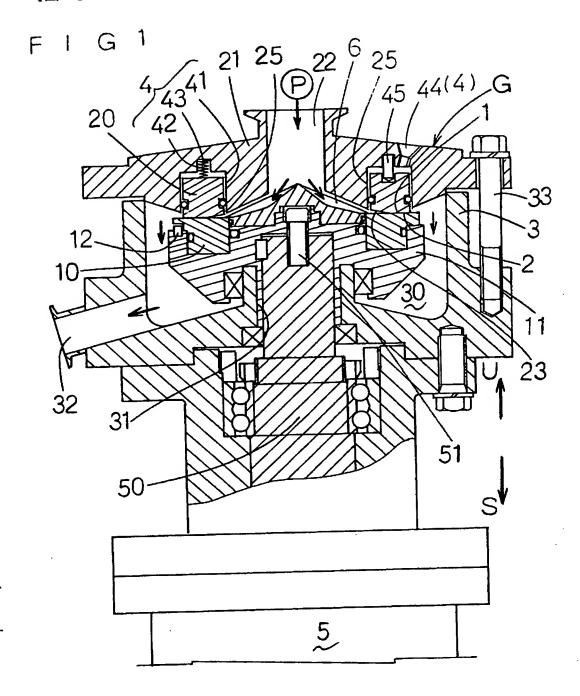
【符号の説明】

- 1 第1処理用部材
- 2 第2処理用部材
- 3 付勢機構
- 4 動圧発生機構

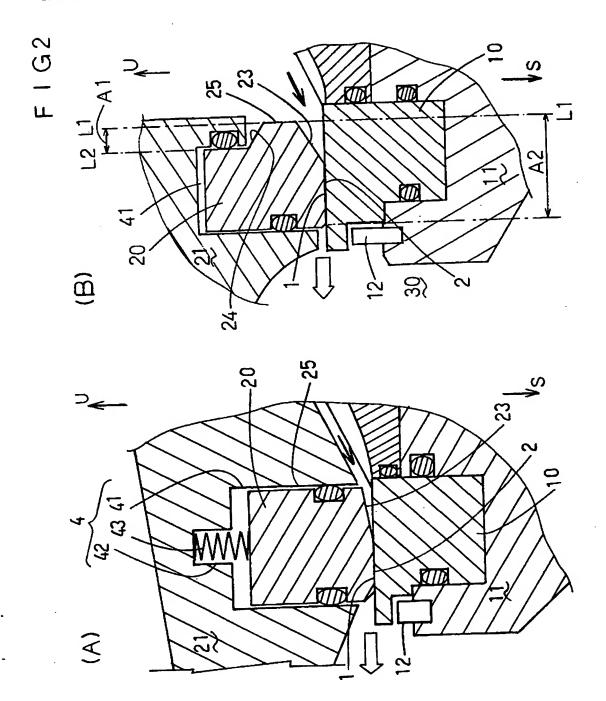
【書類名】

図面

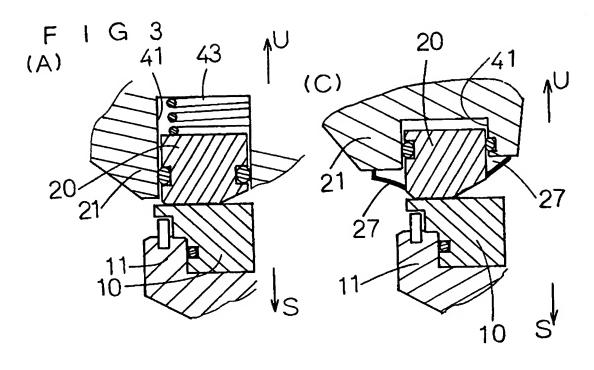
【図1】

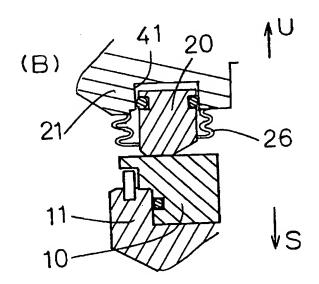


【図2】

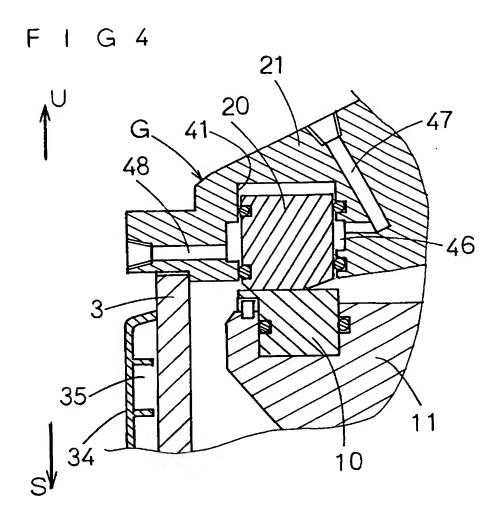


【図3】



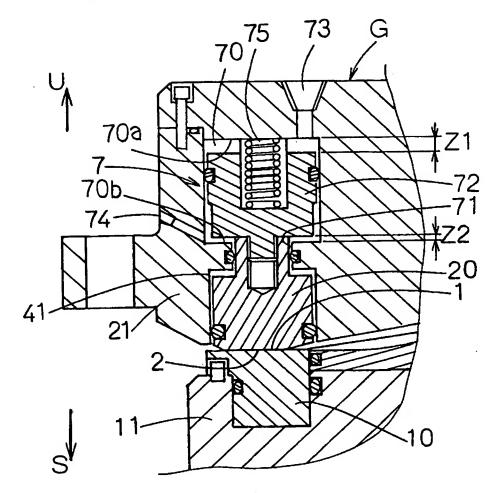


【図4】

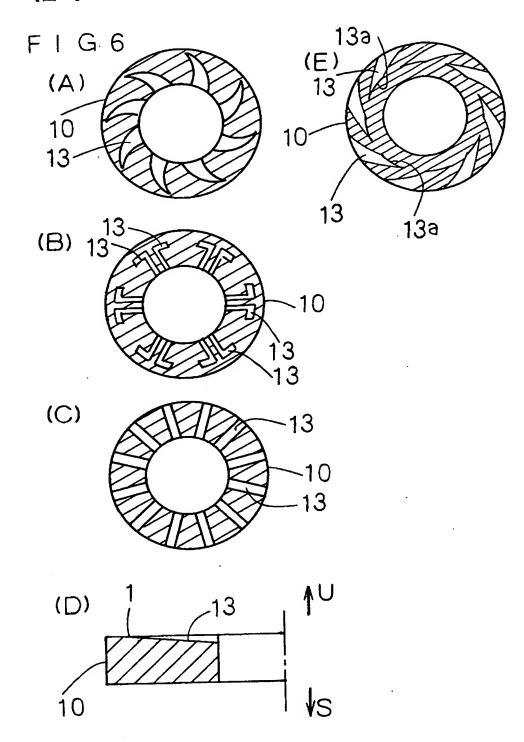


【図5】

F 1 G 5

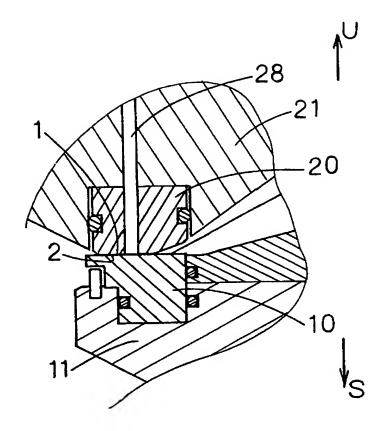


【図6】

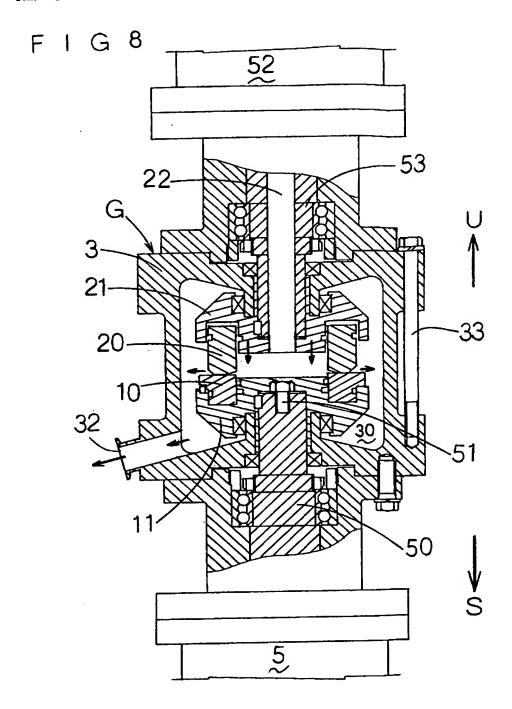


[図7]

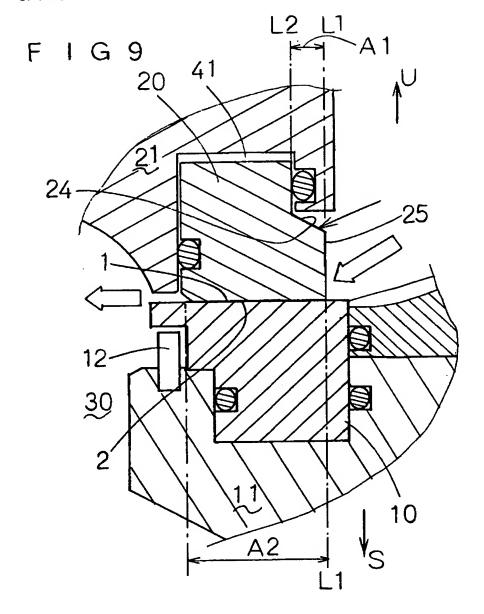
FIG7



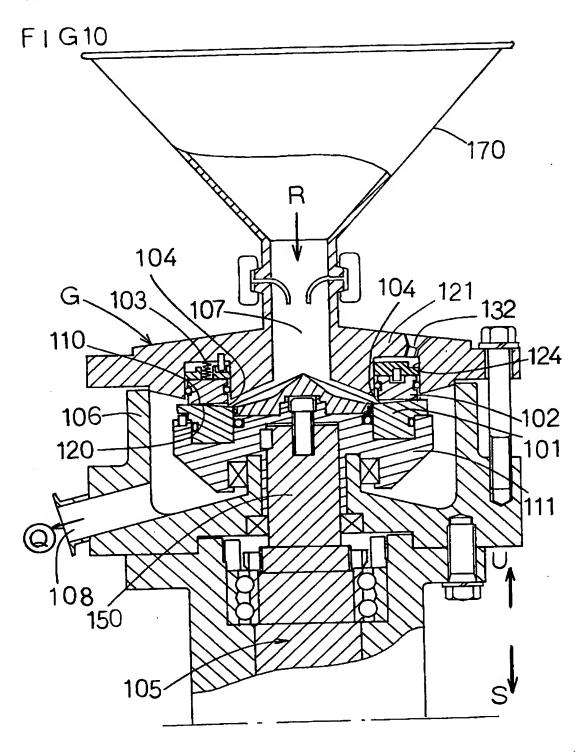
[図8]



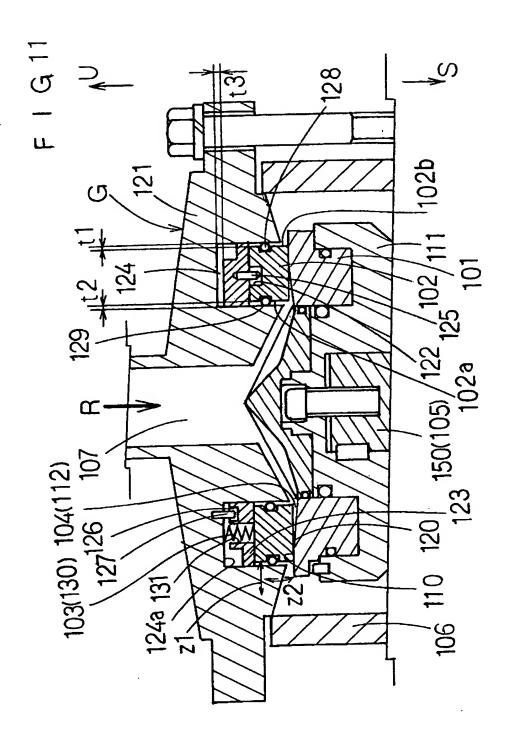
[図9]



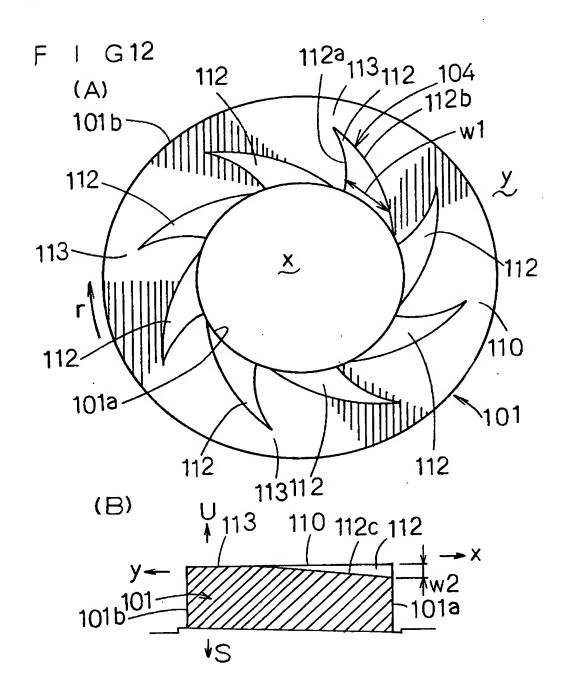
【図10】



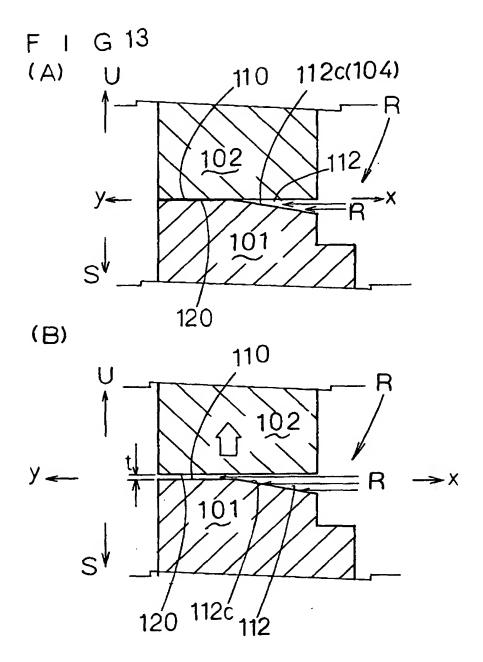
【図11】



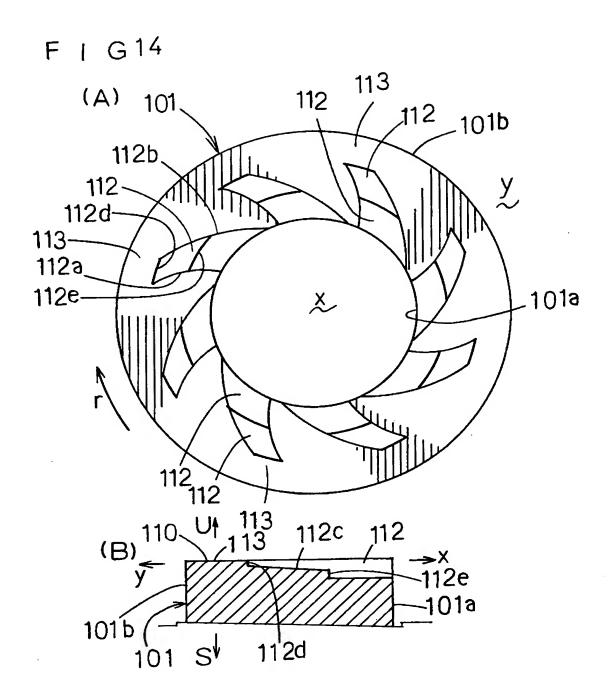
【図12】



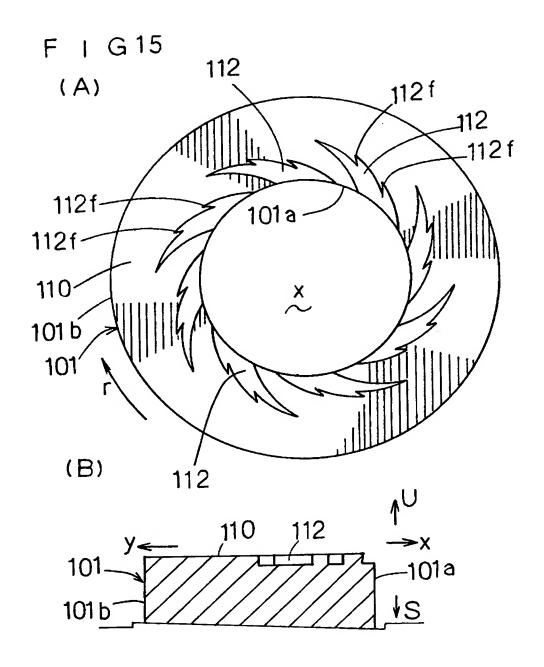
【図13】



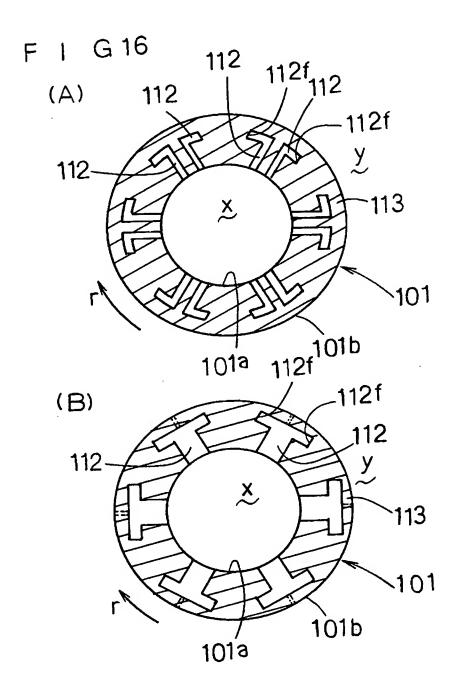
【図14】



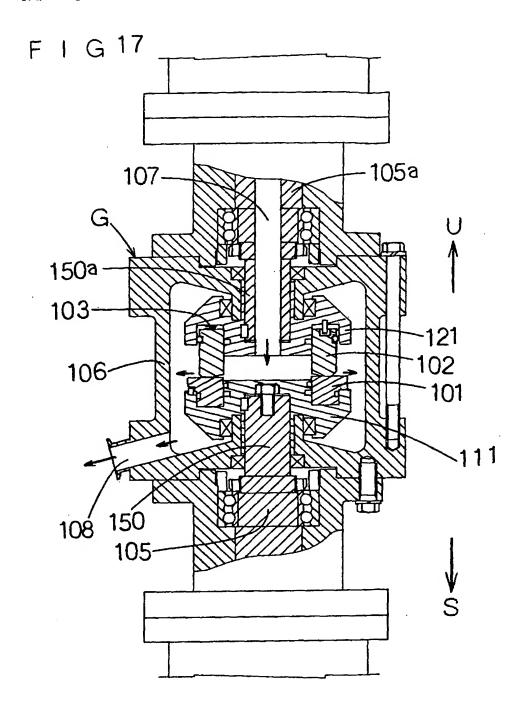
【図15】



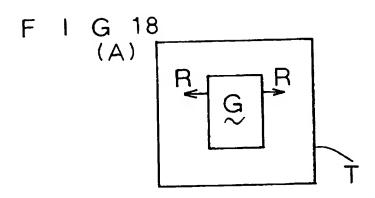
【図16】

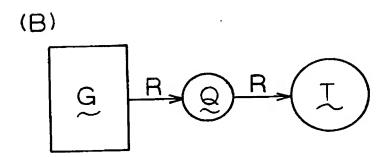


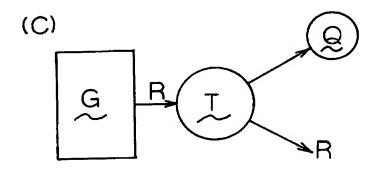
【図17】



【図18】







【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 ・従来不可能であった微細な気泡の脱泡を可能とし、従来の装置の面倒な洗浄作業を不要とする。

【解決手段】 本願発明に係る脱気機は、密封された流体通路中に配置されると 共に互いに対向して当該通路の一部を構成する第1処理用面1及び第2処理用面 2の少なくとも2つの処理用面と、両処理用面1,2を圧接する接面圧力付与機 構とを備え、第1処理用面1に対し、第2処理用面2を相対的に回転させること により、両処理用面1,2間にて、被処理流動体の微細化を行うものである。第 1処理用面1と第2処理用面2とは、上記接面圧力付与機構によって互いに圧接 或いは近接された状態にされ、上記の回転にて、被処理流動体が、第1処理用面 1と第2処理用面2との間に流体膜を形成しながら両処理用面1,2間を通過す ることで、当該被処理流動体について、所望の微細化状態を得るものである。

【選択図】

図 1

出願人履歴情報

識別番号

(595111804)

1. 変更年月日

1999年 8月24日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府大阪市西成区南津守5丁目1番60号

氏 名

エム・テクニック株式会社